## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - I DEDE BINDOLI IN DIGNE NEW EDIN EDIN DIGNIK IN DEDEN NEUE INDENDEN EDIN ERN EINE EN BEREIN EEN KEL HEL

#### (43) 国際公開日 2004 年2 月12 日 (12.02.2004)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2004/013106 A1

(51) 国際特許分類7:

C07D 231/20

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/009762

(22) 国際出願日:

2003 年7 月31 日 (31.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-225083 2002 年8 月1 日 (01.08.2002) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): イハラケミカル工業株式会社 (IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒110-0008 東京都 台東区 池之端 1 丁目 4番 2 6号 Tokyo (JP). クミアイ化学工業株式会社 (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒110-0008 東京都 台東区 池之端 1 丁目 4番 2 6号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中谷 昌央 (NAKATANI,Masao) [JP/JP]; 〒437-1213 静岡県 磐田郡福田町塩新田408番地の1 株式会社ケイ・アイ研究所内 Shizuoka (JP). 伊藤 稔 (ITO,Minoru) [JP/JP]; 〒437-1213 静岡県 磐田郡福田町塩新田408番地の1 株式会社ケイ・アイ研究所内 Shizuoka (JP). 宮崎雅弘 (MIYAZAKI,Masahiro) [JP/JP]; 〒437-1213 静

岡県 磐田郡 福田町塩新田408番地の1 株式会社 ケイ・アイ研究所内 Shizuoka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,

(74) 代理人: 小林 雅人 (KOBAYASHI, Masato); 〒162-0825 東京都 新宿区 神楽坂4丁目3番地 煉瓦塔ピル5階

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

Tokyo (JP).

VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PYRAZOLE DERIVATIVES AND PROCESS FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: ピラゾール誘導体及びその製造方法

$$\mathbb{R}^{2}$$
 $\mathbb{N}$ 
 $\mathbb{R}^{4}$ 
 $\mathbb{N}$ 
 $\mathbb{R}^{1}$ 

(57) Abstract: The invention relates to pyrazole derivatives useful as intermediates in the production of isoxazoline derivatives having excellent herbicidal activity and crops-weeds selectivity and a process for the production thereof. Pyrazole derivatives represented by the general formula [I] or pharmacologically acceptable salts thereof: [I] wherein  $R^1$  is  $C_{1.6}$  alkyl;  $R^2$  is  $C_{1.3}$  haloalkyl;  $R^3$  is hydrogen,  $C_{1.3}$  alkyl which may have one or more substituents selected from group  $\alpha$  of substituents, or formyl; and  $R^4$  is hydrogen or  $C_{1.3}$  haloalkyl (with the proviso that when  $R^3$  is hydrogen or formyl,  $R^4$  is  $C_{1.3}$  haloalkyl, while when  $R^3$  is  $C_{1.3}$  alkyl which may have one or more substituents selected from group  $\alpha$  of substituents,  $R^4$  is hydrogen or  $C_{1.3}$  haloalkyl).

#### (57) 要約:

本発明は、優れた除草効果と作物・雑草間の選択性を有するイソオキサゾリン 誘導体の製造中間体であるピラゾール誘導体、及び、その製造方法に関するもの である。

本発明化合物であるピラゾール誘導体又はその薬理学上許容される塩は、一般式[I]

$$R^{3}$$
 $N$ 
 $N$ 
 $R^{4}$ 
 $N$ 
 $R^{1}$ 
 $R^{1}$ 

 ${\exists r}$  、 ${\tt R}^1$  は、 ${\tt C1} \sim {\tt C6}$  アルキル基を示し、 ${\tt R}^2$  は、 ${\tt C1} \sim {\tt C3}$  ハロアルキル基示し、 ${\tt R}^3$  は、水素原子、下記置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよい  ${\tt C1} \sim {\tt C3}$  アルキル基又はホルミル基を示し、 ${\tt R}^4$  は、水素原子又は  ${\tt C1} \sim {\tt C3}$  ハロアルキル基を示す(但し、 ${\tt R}^3$  が水素原子又はホルミル基である場合、 ${\tt R}^4$  は  ${\tt C1} \sim {\tt C3}$  ハロアルキル基を示し、 ${\tt R}^3$  が下記置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよい  ${\tt C1} \sim {\tt C3}$  アルキル基である場合、 ${\tt R}^4$  は水素原子又は  ${\tt C1} \sim {\tt C3}$  ハロアルキル基を示す。  ${\tt C3}$  で表される。

# 明細書

ピラゾール誘導体及びその製造方法

#### 技術分野

5 本発明は、農医薬製造中間体として有用なピラゾール誘導体に関するもので ある。

### 背景技術

除草剤として有効なイソオキサゾリン誘導体の製造法としては、例えば特開 2002-308857号公報に、イソオキサゾリン環を有する原料化合物を 水硫化ナトリウム水和物と反応させた後、炭酸カリウム及びロンガリットの存在下、4-ブロモメチル-5-クロロ-1-フェニル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾールを反応させる、ピラゾール環を有するイソオキサゾリン 誘導体の製造例が記載されている。

15 本発明は、前記イソオキサゾリン誘導体の有用な製造中間体及び当該中間体 の製造方法を提供することを目的としている

# 発明の開示

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討の結果、容易に入手可能 な原料から製造可能な、特定のピラゾール誘導体を製造中間体として使用する 事により、前記イソオキサゾリン誘導体を、更に効率的且つ簡便に製造することができることを見出し、当該ピラゾール誘導体が前記イソオキサゾリン誘導 体の製造において極めて有用な製造中間体となることを知り、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明は下記(1)乃至(15)の発明を提供することにより上記課題を解決したものである。

## (1) 一般式[I]

$$R^3$$
 $N$ 
 $R^4$ 
 $R^4$ 
 $R^1$ 
 $R^1$ 

5

10

 ${\rm (式 p, R^1 id, C1 \sim C6 }$  アルキル基を示し、 ${\rm R^2 id, C1 \sim C3 }$  アロアルキル基示し、 ${\rm R^3 id, x}$  水素原子、下記置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよい  ${\rm C1 \sim C3 }$  アルキル基又はホルミル基を示し、 ${\rm R^4 id, x}$  水素原子又は  ${\rm C1 \sim C3 }$  ハロアルキル基を示す(但し、 ${\rm R^3 id, x}$  が下記置換上の ${\rm E}$  ルミル基である場合、 ${\rm R^4 id, C1 \sim C3 }$  ハロアルキル基を示し、 ${\rm R^3 id, x}$  が下記置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよい  ${\rm C1 \sim C3 }$  アルキル基である場合、 ${\rm R^4 id, x}$  な素原子又は  ${\rm C1 \sim C3 }$  アルキル基を示す。  ${\rm P}$  で表されるピラゾール誘導体又はその塩。

#### 「置換基群α」

15 ハロゲン原子、-SH基、-SC(=NH) NH<sub>2</sub>基

- (2) R<sup>4</sup> がC1~C3ハロアルキル基である(1) 記載のピラゾール誘導体 又はその塩。
- (3) R<sup>3</sup> がC1~C3アルキル基であり、R<sup>4</sup> が水素原子である(1) 記載の ピラゾール誘導体又はその塩。
- 20 (4)  $R^3$  が置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよいメチル基である(1)記載のピラゾール誘導体又はその塩。
  - (5) R<sup>3</sup> がメチル基である(3) 記載のピラゾール誘導体又はその塩。

(式中、 $R^1$  及び $R^2$  は前記と同じ意味を示し、 $R^5$  は $C1\sim C3$  アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよいベンジル基を示し、 $R^6$  は  $C1\sim C3$  アルキル基を示す。)

一般式[1]で表される化合物と、一般式[2]で表される化合物とを反応 させることを特徴とする、一般式[3]で表されるピラゾール誘導体の製造方 法。

10

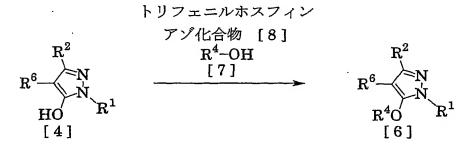
15

5

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$  及び $R^6$  は前記と同じ意味を示し、 $L^1$  はハロアルキル化して残ったハロゲン原子より反応性の高い脱離基であり、ハロゲン原子、 $C1\sim C3$  アルキルスルホニルオキシ基、 $C1\sim C3$  ハロアルキルスルホニルオキシ基、置換されていてもよいフェニルスルホニルオキシ基又は置換されていてもよいベンジルスルホニルオキシ基等を示す。)

一般式 [4] で表される化合物と、一般式 [5] で表される化合物とを、塩 基の存在下で反応させることを特徴とする、一般式 [6] で表されるピラゾー ル誘導体の製造方法。

(8)



(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びR<sup>6</sup>は前記と同じ意味を示す。)

5 一般式 [4] で表される化合物とトリフェニルホスフィン、一般式 [7] で表される化合物及びアゾ化合物 [8] とを反応させることを特徴とする、一般式 [6] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

(9)

10 (式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び $R^4$  は前記と同じ意味を示し、 $R^7$  及び $R^8$  は水素原子 又は $C1\sim C2$  アルキル基を示し、X はハロゲン原子を示す。)

一般式[9]で表される化合物と、ハロゲン化剤とを反応させることを特徴とする、一般式[10]で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

(10)

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>及びXは前記と同じ意味を示す。)

一般式[10]で表される化合物と化合物[11]とを反応させることを特徴とする、一般式[12]で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

5 (11)上記(10)に記載の一般式[12]で表される化合物を加水分解反応させることを特徴とする、一般式[13]で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

(12)上記(10)に記載の一般式[10]で表される化合物と硫化物とを 反応させることを特徴とする、一般式[13]で表されるピラゾール誘導体の 製造方法。

$$R^2$$
 ホルミル化 OHC  $N$  R<sup>1</sup> HO [14]

(式中、R1及びR2は前記と同じ意味を示す。)

一般式[14]で表される化合物をホルミル化させることを特徴とする、一般式[15]で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

(14)

5

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びL<sup>1</sup>は前記と同じ意味を示す。)

一般式 [16]で表される化合物と、一般式 [5]で表される化合物とを、 塩基の存在下で反応させることを特徴とする、一般式 [17]で表されるピラ ゾール誘導体の製造方法。

10 (15)

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びXは前記と同じ意味を示す。)

一般式 [18] で表される化合物をハロメチル化させることを特徴とする、 一般式 [19] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

15

尚、本明細書において、用いられる用語の定義を以下に示す。

C1~C6等の表記は、この場合ではこれに続く置換基の炭素数が、1~6であることを示している。

ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を示す。

20

 $C1\sim C3$  アルキル基とは、特に限定しない限り、炭素数が $1\sim 3$  の直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を示し、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基又はiso-プロピル基等を挙げることができる。

C1~C6アルキル基とは、特に限定しない限り、炭素数が1~6の直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を示し、例えばメチル基、エチル基、nープロピル基、isoープロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーペンチル基、isoーペンチル基、ネオペンチル基、nーペキシル基、isoーペキシル基、又は3,3ージメチルブチル基等を挙げることができる。

C1~C4アルキルスルホニルオキシ基とは、アルキル基部分が前記と同じ意味を示す(C1~C4アルキル)-SO2-O-基を示し、例えばメタンスルホニルオキシ基又はエタンスルホニルオキシ基等を挙げることができる。

C1~C3ハロアルキルスルホニルオキシ基とは、ハロアルキル基部分が前記と同じ意味を示す(C1~C3ハロアルキル)-SO2-O-基を示し、例えばトリフルオロメタンスルホニルオキシ基又はトリクロロメタンスルホニルオキシ基等を挙げることができる。

10

15

20

(置換されていてもよい)フェニル基、(置換されていてもよい)フェニルスルホニルオキシ基、(置換されていてもよい)ベンジル基又は(置換されていてもよい)ベンジルスルホニルオキシ基における、「置換されていてもよい基」とは、例えばハロゲン原子、C1~C10アルキル基、C1~C4ハロアルキル基、C1~C10アルコキシ基、C1~C10アルキルチオ基、C1~C10アルキルスルホニル基、アシル基、C1~C10アルコキシカルボニル基、シアノ基、カルバモイル基(該基の窒素原子は同一又は異なって、C1~C10アルキルメルボニル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキル基、C1~C10アルキルスルボニル基、C1~C10アルキルスルボニル基、C1~C4ハロアルキルカルボニル基で置換されていてもよい)等で置換されていてもよいことを示す。

塩とは、一般式 [I]を有する化合物において、その構造中に、水酸基、一 SH基又は一SC(=NH)NH2基等が存在する場合に、一般式 [I]を有する化合物と、金属もしくは有機塩基との塩又は鉱酸もしくは有機酸との塩である。ここで金属としては、ナトリウム又はカリウム等のアルカリ金属或いはマグネシウム又はカルシウム等のアルカリ土類金属を挙げることができ、有機塩基としてはトリエチルアミン又はジイソプロピルアミン等を挙げることができ、鉱酸としては塩酸、臭化水素酸又は硫酸等を挙げることができ、有機酸としては酢酸、メタンスルホン酸又はpートルエンスルホン酸等を挙げることができる。

#### 発明を実施するための最良の形態

次に、一般式 [I] で表されるピラゾール誘導体又はその塩(本発明化合物)

の代表的な化合物例を表1~表11に記載する。しかしながら、本発明化合物 はこれらに限定されるものではない。

本明細書における表中の次の表記は下記の通りそれぞれ該当する基を表す。

Me :メチル基

5 Εt : エチル基

Pr-n:n-プロピル基

Pr-i:iso-プロピル基

Bu-n:n-ブチル基

Bu-i:iso-ブチル基

10

Bu-s:sec-ブチル基

Bu-t:tert-ブチル基

Pen-n:n-ペンチル基

Hex-n:n-ヘキシル基

尚、本発明化合物が、置換基として水酸基を含む場合、ケトーエノール互変 異性体を有する化合物があるが、何れの異性体もその混合物も本発明化合物に 15 含まれる。

表1

$ \begin{array}{c c} R^2 \\ N \\ N \\ R^4O \end{array} $	R¹ [I]			
化合物番号	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R⁴
001	Me	CF <sub>3</sub>	H	CHF <sub>2</sub>
002	Me	CF₃	Н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
003	Me	CF₃	н	CH₂CF₃
0 0 4	Me	CHF <sub>2</sub>	н	CHF <sub>2</sub>
005	Me	CHF <sub>2</sub>	Н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
006	Me	CHF <sub>2</sub>	H	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
007	Me	CC1F <sub>2</sub>	н	CHF <sub>2</sub>
008	Ме	CC1F2	Н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
009	Et	CF <sub>3</sub>	н	CHF <sub>2</sub>
010	Et	CF₃	н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
011	Et	CF <sub>3</sub>	н	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>

表 2

化合物番号	R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>
0 1 2	Et	CHF <sub>2</sub>	H	CHF <sub>2</sub>
013	Et	CHF <sub>2</sub>	H	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
014	Et	CHF <sub>2</sub>	Н	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
0 1 5	Pr-i	CF <sub>3</sub>	н	CHF <sub>2</sub>
016	Pr-i	CF <sub>3</sub>	н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
017	Pr-i	CF <sub>3</sub>	H	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
018	Pr-n	CF <sub>3</sub>	н	CHF <sub>2</sub>
019	Pr-n	CF <sub>3</sub>	н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
020	Pr-n	CF <sub>3</sub>	Н	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
0 2 1	Bu-t	CF <sub>3</sub>	н	CHF <sub>2</sub>
0 2 2	Bu-t	CF <sub>3</sub>	Н	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
0 2 3	Bu-t	CF <sub>3</sub>	Н	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
024	Pen-n	CF₃	Н	CHF <sub>2</sub>
025	Hex-n	CF <sub>3</sub>	H .	CHF <sub>2</sub>
026	Ме	CF <sub>3</sub>	сно .	CHF <sub>2</sub>
027	Me	CHF <sub>2</sub>	сно	CHF <sub>2</sub>
028	Me	CF <sub>3</sub>	СНО	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
029	Me	CF <sub>3</sub>	сно	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
030	Et	CF <sub>3</sub>	СНО	CHF <sub>2</sub>
031	Et	CF <sub>3</sub>	сно .	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
032	Pr-i	CF₃	сно	CHF <sub>2</sub>
033	Pr-i	CF₃	сно	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
0 3 4	Bu-t	CF <sub>3</sub>	сно	CHF <sub>2</sub>
035	Bu-t	CF₃	СНО	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>

5 表3

$R^{3}$ $R^{4}O$	$\mathbb{R}^3$ $\mathbb{N}_{\mathbb{R}^1}$				
h C					
化合物 番号	$\mathbb{R}^1$	R <sup>2</sup>	$\mathbb{R}^3$	R4	
036	Me	$\mathbf{CF_3}$	Me	H	
037	Et	CF <sub>3</sub>	Me	H	
038	Pr-i	CF <sub>3</sub>	Me	H	
039	Pr-n	CF <sub>3</sub>	Me	H	
040	Bu-n	CF <sub>3</sub>	Me	H	
041	Bu-s	CF <sub>3</sub>	Me	н	
042	Bu-i	CF <sub>3</sub>	Me	H	
043	Bu-t	CF <sub>3</sub>	Me	H	
044	Pen-n	CF <sub>3</sub>	Me	н .	
045	Hex-n	CF <sub>3</sub>	Me	H	
046	Me	CHF <sub>2</sub>	Me	H	
047	Et	CHF <sub>2</sub>	Me .	H	
048	Pr-i	CHF <sub>2</sub>	Me	H	
049	Pr-n	CHF <sub>2</sub>	Me	H	
050	Bu-n	CHF <sub>2</sub>	Me	H	
051	Bu-s	CHF <sub>2</sub>	Me	н	
052	Bu-i	CHF <sub>2</sub>	Me	H	
053	Bu-t	CHF <sub>2</sub>	Me	н	
054	Pen-n	CHF <sub>2</sub>	Me	н	
055	Hex-n	$CHF_2$	Me	н	
056	Me	CF <sub>3</sub>	Et	н	
057	Et	CF <sub>3</sub>	Et	н	
058	Pr-i	CF <sub>3</sub>	Et	н	
059	Pen-n	CF <sub>3</sub>	Et	н	
060	Hex-n	CF <sub>3</sub>	Et	н	
061	Me	CHF2	Et	H	
062	Et	CHF2	Et	H	
063	Pr-i	CHF2	Et	н	
064	Me	CF <sub>3</sub>	Pr-n	H	
065	Et	CF <sub>3</sub>	Pr-n	H	
066	Pr-i	CF <sub>3</sub>	Pr-n	H	

表4

化合物	Γ.			
番号	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	R <sup>3</sup>	$\mathbb{R}^4$
067	Me	CHF <sub>2</sub>	Pr-n	H
068	Et	CHF <sub>2</sub>	Pr-n	H ·
069	Pr-i	CHF <sub>2</sub>	Pr-n	H
070	Me	$CF_3$	Pr-i	H
071	Et	$\mathbf{CF_3}$	Pr-i	H
072	Pr-i	$\mathbf{CF}_3$	Pr-i	H
073	Me	$CHF_2$	Pr-i	H
074	Et	$CHF_2$	Pr-i	Н
075	Pr-i	$CHF_2$	Pr-i	H
076	Me	$CF_3$	Me	CHF <sub>2</sub>
077	Me	$CHF_2$	Me	CHF <sub>2</sub>
078	Me	$\mathbf{CF_3}$	Me	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
079	Me	$CF_3$	Me	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
080	Et	$CF_3$	Me	CHF <sub>2</sub>
081	Et	$CHF_2$	Me	$\mathrm{CHF}_2$
082	Et	$\mathbf{CF_3}$	Me	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
083	Et	$\mathbf{CF_3}$	Me	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
084	Pr-i	$\mathbf{CF_8}$	Me	$\mathrm{CHF}_2$
085	Pr-i	$\mathrm{CHF}_2$	Me	CHF <sub>2</sub>
086	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	Ме	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
087	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	Me	$\mathrm{CH_2CF_3}$
088	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	CHF <sub>2</sub>
089	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
090	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	$\mathrm{CH_2CF_3}$
091	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	CHF <sub>2</sub>
092	Bu-n	$\mathbf{CF_8}$	Me .	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
093	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	$\mathrm{CH_2CF_3}$
094	Bu-i	$\mathbf{CF_3}$	Me	$CHF_2$
095	Bu-i	$\mathbf{CF_3}$	Me	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
096	Bu-i	$\mathbf{CF_3}$	Me	$\mathrm{CH_2CF_3}$
097	Bu-s	$\mathbf{CF_3}$	Me	$\mathbf{CHF_2}$
098	Bu-s	CF <sub>3</sub>	Me	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
099	Bu-s	$\mathbf{CF_3}$	Me	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
100	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	Me	CHF2
101	Bu-t	$\mathbf{CF}_3$	Me	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>

表 5

			<del></del>	
化合物 番号	$\mathbb{R}^1$	R <sup>2</sup>	$\mathbb{R}^3$	R <sup>4</sup>
102	Bu-t	CF <sub>3</sub>	Me	$ m CH_2CF_3$
103	Pen-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	$CHF_2$
104	Hex-n	$\mathbf{CF_3}$	Me	$CHF_2$
105	Me	$\mathbf{CF_3}$	Et	$ m CHF_2$
106	Me	CF <sub>3</sub>	Et	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
107	Et	CF <sub>3</sub>	Et	CHF <sub>2</sub>
108	Et	CF <sub>3</sub>	Et	$\mathrm{CH_{2}CHF_{2}}$
109	Pr-i	$\mathbf{CF}_3$	Et	$\mathrm{CHF}_2$
110	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	Et	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
111	Me	$\mathbf{CF_3}$	Pr-n	$\mathrm{CHF}_2$
112	Me ·	$\mathbf{CF}_3$	Pr-n	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
113	Et	CF <sub>3</sub>	Pr-n	CHF <sub>2</sub>
114	Et	CF <sub>3</sub>	Pr-n	$CH_2CHF_2$
115	Pr-i	CF <sub>3</sub>	Pr-n	$CHF_2$
116	Pr-i	CF3	Pr-n	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
117	Me	$\mathbf{CF_3}$	Pr-i	$CHF_2$
118	Me	CF3	Pr-i	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
119	Et	$\mathbf{CF_3}$	Pr-i	$CHF_2$
120	Et	CF <sub>3</sub>	Pr-i	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
121	Pr-i	CF3	Pr-i	CHF <sub>2</sub>
122	Pr-i	CF <sub>3</sub>	Pr-i	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
123	Me	CF <sub>3</sub>	CH₂Cl	CHF <sub>2</sub>
124	Me	CHF <sub>2</sub>	CH₂Cl .	CHF <sub>2</sub>
125	Me	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
126	Me	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
127	Et	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CHF <sub>2</sub>
128	Et	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
129	Et	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
130	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	$CHF_2$
131	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
132	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
133	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CHF2
134	Pr-n	CF3	CH₂Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
135	Pr-n	CF <sub>8</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
136	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH₂Cl	CHF <sub>2</sub>

表 6

				·
化合物 番号	R <sup>1</sup>	$\mathbb{R}^2$	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>
1 3 7	Bu-n	$\mathbf{CF}_3$	CH <sub>2</sub> Cl	$CH_2CHF_2$
138	Bu-n	$\mathbf{CF}_3$	CH <sub>2</sub> Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
140	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Cl	CHF2
141	Bu-t	$\mathbf{CF}_3$	CH₂Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
142	Bu-t	CF3	CH₂Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
143	Me	CF3	CH(Me)Cl	CHF2
144	Me	$CHF_2$	CH(Me)Cl	CHF2
145	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH(Me)Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
146	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Me)Cl	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
147	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH(Et)Cl	CHF2
148	Me	$CHF_2$	CH(Et)Cl	CHF2
149	Me	$\mathbf{CF}_3$	CH(Et)Cl	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
150	Me	$CF_3$	CH(Et)Cl	$\mathrm{CH_2CF_3}$
151	Me	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Br	CHF2
152	Me	$\mathrm{CHF_2}$	CH <sub>2</sub> Br	CHF2
153	Me	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
154	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
155	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CHF <sub>2</sub>
156	Et	CF3	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
157	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
158	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CHF2
159	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
160	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
161	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> Br	CHF2
162	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
163	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
164	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Br	CHF2
165	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
166	Bu-n	CF3	CH₂Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
167	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH₂Br	CHF2
168	Bu-t	CF3	CH <sub>2</sub> Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
169	Bu-t	CF3	CH₂Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
170	Me	CF3	CH(Me)Br	CHF2
171	Me	CHF2	CH(Me)Br	CHF2
172	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Me)Br	$CH_2CHF_2$

表7

110 A Hilm		·		
化合物 番号	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$	R <sup>4</sup>
173	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Me)Br	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
174	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Et)Br	$\mathrm{CHF}_2$
175	Me	CHF <sub>2</sub>	CH(Et)Br	$\mathrm{CHF}_2$
176	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Et)Br	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
177	Me	$\mathbf{CF}_3$	CH(Et)Br	$\mathrm{CH_2CF_3}$
178	Me	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HCl塩	$CHF_2$
17.9	Me	$CHF_2$	CH₂SC(=NH)NH₂ HCl塩	$\mathrm{CHF}_2$
180	Me	CF3	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	$CH_2CHF_2$
181	Me	CF <sub>3</sub>	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	$ m CH_2CF_3$
182	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	$CHF_2$
183	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
184	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
185	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	$CHF_2$
186	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
187	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
188	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CHF <sub>2</sub>
189	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
190	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
191	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HCl塩	$CHF_2$
192.	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH₂SC(=NH)NH₂ HCl塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
193	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
194	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HCl塩	$CHF_2$
195	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HCl塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
196	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HCl塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
197	Me	$CF_3$	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CHF2
198	Me	$CHF_2$	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	CHF <sub>2</sub>
199	Me	CF <sub>3</sub>	CH2SC(=NH)NH2 HBr塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
200	Me	CF <sub>3</sub>	CH2SC(=NH)NH2 HBr塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
201	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CHF <sub>2</sub>
202	Et	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
203	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
204	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CHF <sub>2</sub>
205	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
206	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
207	Pr-n	CF3	CH <sub>2</sub> SC(=NH)NH <sub>2</sub> HBr塩	CHF2

表8

	,			<del></del>
化合物 番号	R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>
208	Pr-n	$\mathbf{CF}_3$	CH2SC(=NH)NH2 HBr塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
209	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	CH2SC(=NH)NH2 HBr塩	$\mathrm{CH_2CF_3}$
210	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	$\mathrm{CHF}_2$
211	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
212	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
213	Bu-t	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	$\mathrm{CHF}_2$
214	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
215	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SC(=NH)NH₂ HBr塩	$\mathrm{CH_2CF_3}$
216	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	$\mathbf{CHF}_2$
217	Me	$CHF_2$	CH₂SH	$\mathrm{CHF}_2$
218	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
219	Me	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
220	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	$\mathrm{CHF}_2$
221	Et	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
222	Et	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
223	Pr-i	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CHF <sub>2</sub>
224	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
225	Pr-i	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
226	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> SH	CHF <sub>2</sub>
227	Pr-n	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
228	Pr-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
229	Bu-n	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CHF2
230	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
231	Bu-n	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
232	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH₂SH	$\mathbf{CHF}_2$
233	Bu-t	$\mathbf{CF}_3$	CH₂SH	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
234	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
235	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH(Me)SH	CHF <sub>2</sub>
236	.Me	CHF2	CH(Me)SH	CHF2
237	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH(Me)SH	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
238	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH(Me)SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
239	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Et)SH	$CHF_2$
240	Me	CHF2	CH(Et)SH	CHF <sub>2</sub>
241	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Et)SH	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
242	Me	CF <sub>3</sub>	CH(Et)SH	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>

表 9

化合物 番号	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	R³	$\mathbb{R}^4$
243	Me	CF <sub>3</sub>	CH₂S·Na⁺塩	$\mathrm{CHF}_2$
244	Me	$\dot{ ext{CHF}}_2$	CH₂S·Na+塩	$\mathrm{CHF}_2$
245	Me	$\mathbf{CF}_3$	CH <sub>2</sub> S-Na+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
246	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH <sub>2</sub> S·Na+塩	$\mathrm{CH_2CF_3}$
247	Et	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> S·Na+塩	$\mathrm{CHF}_2$
248	Et	CF <sub>3</sub>	CH₂S·Na⁺塩	$\mathrm{CH_2CHF_2}$
249	Et	$\mathbf{CF}_3$	CH₂S-Na+塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
250	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH₂S·Na+塩	$\mathrm{CHF}_2$
251	Pr-i	$\mathbf{CF}_3$	CH <sub>2</sub> S·Na+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
252	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH₂S⁻Na+塩	$\mathrm{CH_2CF_3}$
253	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> S-Na+塩	$\mathrm{CHF}_2$
254	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH₂S·Na+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
255	Pr-n	CF3	CH₂S⁻Na⁺塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
256	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH₂S⁻Na+塩	$\mathrm{CHF}_2$
257	Bu-n	$\mathbf{CF}_3$	CH <sub>2</sub> S-Na+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
258	Bu-n	$\mathbf{CF}_3$	CH₂S·Na⁺塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
259	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH₂S-Na⁺塩	$\mathrm{CHF}_2$
260	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> S-Na+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
261	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH₂S⁻Na⁺塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
262	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH₂S·K⁺塩	CHF <sub>2</sub>
263	Me	$\mathrm{CHF}_2$	CH₂S·K⁺塩	CHF <sub>2</sub>
264	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH₂S·K⁺塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
265	Me	$\mathbf{CF_3}$	CH₂S·K+塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
266	Et	CF <sub>3</sub>	CH₂S·K⁺塩	CHF2
267	Et	CF <sub>3</sub>	CH₂S·K+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
268	Et	CF <sub>3</sub>	CH₂S·K+塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
269	Pr-i	$\mathbf{CF_3}$	CH₂S·K+塩	$\mathrm{CHF}_2$
270	Pr-i	CF <sub>3</sub>	CH₂S·K⁺塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
271	Pr-i	$\mathbf{CF_{8}}$	CH₂S·K⁺塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
272	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH₂S-K+塩	CHF2
273	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> S·K+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
274	Pr-n	CF <sub>3</sub>	CH₂S-K+塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
275	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH₂S·K⁺塩	$\mathrm{CHF}_2$
276	Bu-n	CF3	CH₂S·K+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
277	Bu-n	CF <sub>3</sub>	CH₂S·K⁺塩	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>

表10

化合物 番号	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>
278	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH₂S·K+塩	$\mathrm{CHF}_2$
279	Bu-t	CF <sub>3</sub>	CH₂S-K+塩	CH <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>
280	Bu-t	$\mathbf{CF_3}$	CH₂S-K+塩	$ m CH_2CF_3$

表11

5

R <sup>2</sup> N HO	$ m R^1$		
化合物番号	R¹	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
281	Ме	CF₃	СНО
282	Et	CF₃	СНО
283	Pr-i	CF₃	СНО
284	Pr-n	CF₃	сно
285	Bu-n	CF₃	СНО
286	Bu-s	CF₃	СНО
287	Bu-i	CF₃	СНО
288	Bu-t	CF <sub>3</sub>	СНО
289	Pen-n	CF <sub>3</sub>	СНО
290	Hex-n	CF₃	СНО
291	Me	CHF <sub>2</sub>	СНО
292	Et	CHF <sub>2</sub>	СНО
293	Pr-i	CHF <sub>2</sub>	сно
294	Bu-t	CHF <sub>2</sub>	СНО
295	Pen-n	CHF <sub>2</sub>	сно
296	Hex-n	CHF <sub>2</sub>	СНО

一般式 [I] で表される本発明化合物は、例えば、以下に示す製造法に従って製造することができるが、これらの方法に限定されるものではない。

以下、製造方法を製造法毎に詳説する。

#### <製造法1>

$$R^{1}NHNH_{2}$$
  $R^{2}$   $R^{2}$   $R^{6}$   $R^{2}$   $R^{6}$   $R^{2}$   $R^{6}$   $R^{1}$   $R^{6}$   $R^{1}$   $R^{1}$   $R^{1}$   $R^{1}$   $R^{1}$   $R^{1}$   $R^{1}$   $R^{1}$ 

5

(式中、 $R^1$  及び $R^2$  は前記と同じ意味を示し、 $R^5$  は $C1\sim C3$  アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよいベンジル基を示し、 $R^6$  は  $C1\sim C3$  アルキル基を示す。)

(工程1)

10 一般式[3]で表される化合物は、一般式[1]で表される化合物と、一般式[2]で表される化合物とを、溶媒中又は溶媒の非存在下で(好ましくは適当な溶媒中)、酸触媒の存在下又は非存在下で反応させることにより製造することができる。

反応温度はいずれの反応も-50℃から反応系における還流温度までの任意 15 の温度で行い、好ましくは-20℃ $\sim100$ ℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが0.5時間 $\sim72$ 時間で終了する。

反応に供される試剤の量は一般式 [1] で表される化合物 1 当量に対して、一般式 [2] で表される化合物は  $1\sim3$  当量であり、酸触媒を使用する場合は、酸触媒  $0.01\sim2$  当量である。

20 溶媒としては、例えばジオキサン、テトラヒドロフラン又はジメトキシエタン等のエーテル類;ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン又はジクロ

ロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージメチルホルムアミド又はNーメチルー2ーピロリジノン等のアミド類;ジメチルスルホキシド又はスルホラン等の硫黄化合物;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;メタノール、エタノール、nープロパノール、2ープロパノール、nーブタノール又は2ーメチルー2ープロパノール等のアルコール類;ギ酸又は酢酸等のカルボン酸類;水;或いはこれらの混合物が挙げられる。溶媒の使用量は一般式[1]で表される化合物1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

10 酸触媒としては、例えば塩酸、臭化水素酸又は硫酸等の鉱酸類;ギ酸、酢酸、メタンスルホン酸又はp-トルエンスルホン酸等の有機酸類が挙げられる。
<製造法2>

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$  及び $R^6$  は前記と同じ意味を示し、 $L^1$  はハロアルキル化して残ったハロゲン原子より反応性の高い脱離基であって、ハロゲン原子、 $C1\sim C3$  アルキルスルホニルオキシ基、 $C1\sim C3$  ハロアルキルスルホニルオキシ基、置換されていてもよいフェニルスルホニルオキシ基又は置換されていてもよいベンジルスルホニルオキシ基等を示すのであり、例えば $R^4$  がCH  $F_2$  基の場合は塩素原子又は臭素原子を表し、 $CH_2$   $CF_3$  基の場合は塩素原子、P シスルホニルオキシ基又はオタンスルホニルオキシ基等を示す。)

#### (工程2)

5

10

一般式 [6] で表される化合物は、一般式 [4] で表される化合物と、一般式 [5] で表される化合物とを、溶媒中又は溶媒の非存在下で(好ましくは適当な溶媒中)、触媒の存在下又は非存在下で、塩基の存在下で反応させることにより製造することができる。

反応温度はいずれの反応も0  $\mathbb{C}$ から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0  $\mathbb{C}$   $\sim$  1 0 0  $\mathbb{C}$  の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが0. 5 時間  $\sim$  2 4 時間で終了する。

反応に供される試剤の量は一般式 [4] で表される化合物 1 当量に対して、一般式 [5] で表される化合物で表される化合物は  $1\sim5$  当量であり、好ましくは  $1\sim3$  当量であり、塩基は  $1\sim2$  0 当量であり、好ましくは  $1\sim1$  0 当量であり、触媒は  $1\sim2$  0 当量であり、好ましくは  $1\sim1$  0 当量であり、独媒は  $1\sim2$  0 当量であり、好ましくは  $1\sim1$  0 1  $1\sim2$  0 1  $1\sim$ 

塩基としては、例えば炭酸ナトリウム又は炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩、炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム等のアルカリ金属重炭酸塩、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物、水素化カリウム又は水素化ナトリウム等アルカリ金属水素化物、ナトリウムエトキシド又はナトリウムメトキシド等のアルカリ金属アルコラート、或いは1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、トリエチルアミン又はピリジン20 等の有機塩基が挙げられる。

溶媒としては、例えばジオキサン、テトラヒドロフラン又は1,2ージメトキシエタン等のエーテル類;ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン又はジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージメチルホルムアミド又はNーメチルー2ーピロリジノン等のア

ミド類;ジメチルスルホキシド又はスルホラン等の硫黄化合物;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;メタノール、エタノール、ロープロパノール、2ープロパノール、ローブタノール又は2ーメチルー2ープロパノール等のアルコール類;アセトン又はメチルエチルケトン等のケトン類;アセトニトリル等のニトリル類;水;或いはこれらの混合物が挙げられる。溶媒の使用量は一般式[4]で表される化合物1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

触媒としては、例えば18-クラウン-6又は15-クラウン-5等のクラウンエーテル類;テトラーnーブチルアンモニウムブロミド又はベンジルトリメチルアンモニウムブロミド等の四級アンモニウム塩;或いはテトラーnーブチルホスホニウムブロミド等の四級ホスホニウム塩が挙げられる。

#### <製造法3>

5

10

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びR<sup>6</sup>は前記と同じ意味を示す。)

#### 15 (工程3)

一般式[6]で表される化合物は、一般式[4]で表される化合物を溶媒中、 [8]のアゾ化合物及びトリフェニルホスフィンの存在下、一般式[7]で表 される化合物とを、シンセシス(Synthesis),1981年,1-28頁に記載の方法に準じて反応させることにより製造することができる。

20 この反応は通常、反応温度-30~100℃で、10分~24時間反応させ

る。

5

10

反応に供される試剤の量は、一般式[4]で表される化合物1当量に対して、一般式[7]で表される化合物1~1.5当量、[8]のアゾ化合物1~1.5当量、トリフェニルホスフィン1~1.5当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させることができる。

溶媒としては、例えばジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類;1,2-ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン又はジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド又はN-メチル-2-ピロリジノン等のアミド類;ジメチルスルホキシド又はスルホラン等の硫黄化合物;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;アセトニトリル等のニトリル類;又はこれらの混合物等が挙げられる。溶媒の使用量は、一般式[4]で表される化合物1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

15 [8] のアゾ化合物としては、例えばアゾジカルボン酸ジエチル又はアゾジ カルボン酸ジイソプロピル等が挙げられる。

<製造法4>

(工程4)

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び $R^4$  は前記と同じ意味を示し、 $R^7$  及び $R^8$  は水素原子 20 又は $C1\sim C3$  アルキル基を示し、Xはハロゲン原子を示す。)

一般式 [10]で表される化合物は、一般式 [9]で表される化合物と、ハロゲン化剤とを溶媒中、触媒の存在下又は非存在下で反応させることにより製造することができる。本工程では光照射下で反応をおこなってもよい。さらに副生する酸を捕捉する為に、塩基の存在下でおこなってもよい。

5 この反応は通常、反応温度20~150℃で10分~48時間反応させる。 反応に供される試剤の量は、一般式[9]で表される化合物1当量に対して、 ハロゲン化剤1~10当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させ ることができる。触媒は0.01~3.0当量、好ましくは0.01~1.5 当量である。

10 ハロゲン化剤としては、例えば臭素又は塩素等のハロゲン類; Nープロモコハク酸イミド、Nークロロコハク酸イミド等のNーハロコハク酸イミド類; 過臭化ピリジニウム等のピリジン塩類、塩化スルフリル、1,3ージプロモー5,5ージメチルヒダントイン等が挙げられる。

溶媒としては、例えば1,2-ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼ 15 ン、フルオロベンゼン又はジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;ベン ゼン;ギ酸又は酢酸等のカルボン酸類;水;或いはこれらの混合物が挙げられ る。溶媒の使用量は、一般式[9]で表される化合物1モルに対して溶媒0. 1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

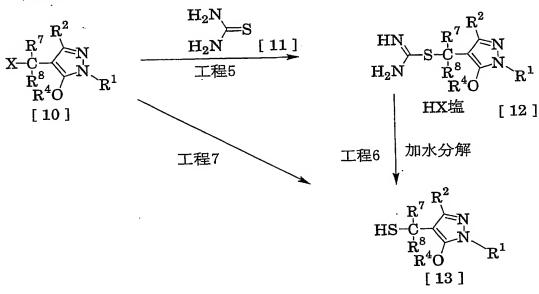
触媒としては、例えば過酸化ベンゾイル、過酸化水素水、α,α'ーアゾビ 20 スイソブチロニトリル又はこれらの混合物等が挙げられる。

塩基としては、例えば水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウム又は炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩、或いは炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム等のアルカリ金属重炭酸塩等が挙げられる。

### <製造法5>

10

15



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^7$ 、 $R^8$  及びXは前記と同じ意味を示す。) (工程 5)

5 一般式 [12] で表される化合物は、一般式 [10] で表される化合物を溶 媒中、式 [11] で表される化合物 (チオ尿素) と反応させることにより製造 することができる。

反応に供される試剤の量は、一般式 [10]で表される化合物1当量に対して、式 [11]で表される化合物1~1.5当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させることができる。

溶媒としては、例えばジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類;ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン又はジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージメチルホルムアミド又はNーメチルー2ーピロリジノン等のアミド類;メタノール、エタノール又は2ープロパノー

ル等のアルコール類;アセトニトリル等のニトリル類;アセトン又はメチルエチルケトン等のケトン類;水、或いはこれらの混合物等が挙げられる。溶媒の使用量は、一般式[10]で表される化合物1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

# 5 (工程6)

10

一般式[13]で表される化合物は、一般式[12]で表される化合物を溶媒中、塩基の存在下又は非存在下、加水分解反応させることにより製造することができる。本工程は、還元剤の存在下又は不活性ガス気流下で製造してもよい。また一般式[13]で表される化合物は、単離精製すること無く次反応に用いてよい。

反応に供される試剤の量は一般式[12]で表される化合物1当量に対して、 塩基1~10当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させることが できる。

溶媒としては、例えばジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類;ジ
クロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン又はジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージメチルホルムアミド又はNーメチルー2ーピロリジノン等のアミド類;ジメチルスルホキシド又はスルホラン等の硫黄化合物;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;アセトニトリル等のニトリル類;メタノール、エタノール又は2ープロパノール等のアルコール類;アセトン又はメチルエチルケトン等のケトン類;水;或いはこれらの混合物等が挙げられる。溶媒の使用量は、一般式[12]で表される1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

塩基としては、例えば炭酸ナトリウム又は炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩;水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物;炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム等のアルカリ金属重炭酸塩;ナトリウムエトキシド又はナトリウムメトキシド等のアルカリ金属アルコラート;或いは1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等の有機塩基が挙げられる。

還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム等が挙げられる。 不活性ガスとしては、例えば窒素又はアルゴン等が挙げられる。 (工程7)

- 10 一般式 [13] で表される化合物は、一般式 [10] で表される化合物を溶媒中、塩基の存在下又は非存在下、硫化物と反応させることにより製造することができる。本工程は、還元剤の存在下又は不活性ガス気流下で製造してもよい。また一般式 [13] で表される化合物は、単離精製すること無く次反応に用いてもよい。
- 15 反応に供される試剤の量は、一般式 [10] で表される化合物1当量に対して、硫化物1~5当量、塩基1~10当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させることができる。

溶媒としては、例えばジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類;ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン又はジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージメチルホルムアミド又はNーメチルー2ーピロリジノン等のアミド類;ジメチルスルホキシド又はスルホラン等の硫黄化合物;ベンゼン、トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素類;アセトニトリル等のニトリル類;メタノール、エタノール又は2ープロパノール等のア

ルコール類;アセトン又はメチルエチルケトン等のケトン類;水;或いはこれらの混合物等が挙げられる。溶媒の使用量は、一般式[10]で表される1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

5 硫化物としては、硫化ナトリウム又は硫化カリウム等のアルカリ金属硫化物、水硫化ナトリウム又は水硫化カリウム等のアルカリ金属水硫化物、硫化水素、硫化アンモニウム、チオ酢酸ナトリウム及びチオ酢酸カリウム等が挙げられる。

塩基としては、例えば炭酸ナトリウム又は炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩;水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物;水素 化カリウム又は水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;ナトリウムエトキシド又はナトリウムメトキシド等のアルカリ金属アルコラート;或いは1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等の有機塩基が挙げられる。

還元剤及び不活性ガスとしては、製造法5工程6と同様なものが挙げられる。 15 <製造法6>

$$R^2$$
 ホルミル化 OHC N HO  $R^1$  [15]

(式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は前記と同じ意味を示す。)

(工程8)

一般式 [15] で表される化合物は、オーガニック シンセシス(Org.
 20 Synth.),第IV巻,831頁(1963)に記載のビルスマイヤー(Vilsmeier)法に準じて、一般式 [14]で表される化合物とN,Nージメチルホルムアミドとを、塩化ホスホリル、ホスゲン又は塩化チオニルの存

10

在下、溶媒中又は溶媒の非存在下で反応させるか、或いはケミーシェ ベリヒテ (Chem. Ber.),第93巻,88頁(1960)に記載の方法に準じて、一般式 [14]で表される化合物とジハロゲノメチルエーテルとを、溶媒中、ルイス酸存在下で反応させた後、加水分解させる方法により製造することができる。

この反応は通常、反応温度-40~150℃で10分~24時間反応させる。 反応に供される試剤の量は、一般式 [14] で表される化合物1当量に対して、塩化ホスホリル、ホスゲン、塩化チオニル、N, N-ジメチルホルムアミド、ルイス酸又はジハロゲノメチルエーテル1~1.5当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させることができる。

ルイス酸としては、例えば四塩化チタン、四塩化スズ、塩化亜鉛、塩化アル ミニウム又は臭化亜鉛等が挙げられる。

ジハロゲノメチルエーテルとしては例えばジクロロメチルメチルエーテル等が挙げられる。

15 溶媒としては、例えばジクロロエタン、四塩化炭素又はクロロホルム等のハロゲン化炭化水素類;ヘキサン又はヘプタン等の脂肪族炭化水素類;ジオキサン又はテトラヒドロフラン等のエーテル類;酢酸等のカルボン酸類;N,Nージメチルホルムアミド等のアミド類;二硫化炭素;或いはそれらの混合物が挙げられる。溶媒の使用量は、一般式[14]で表される化合物1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.2~5リットルの割合である。

<製造法7>

OHC 
$$\mathbb{R}^2$$
  $\mathbb{R}^4$ — $\mathbb{L}^1$   $\mathbb{R}^2$  OHC  $\mathbb{N}$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^2$   $\mathbb{R}^4$   $\mathbb{R}^1$   $\mathbb{R}^4$   $\mathbb{R}^1$   $\mathbb{R}^4$   $\mathbb{R}^1$   $\mathbb{R}^4$   $\mathbb{R$ 

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$  及び $L^1$  は前記と同じ意味を示す。)

## (工程9)

5

15

一般式 [17] で表される化合物は、一般式 [16] で表される化合物と、一般式 [5] で表される化合物とを、溶媒中又は溶媒の非存在下で(好ましくは適当な溶媒中)、触媒の存在下又は非存在下で、塩基の存在下で反応させることにより製造することができる。

反応温度はいずれの反応も0 $\mathbb{C}$ から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0 $\mathbb{C}$ ~100 $\mathbb{C}$ の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが0.5時間~24時間で反応させる。

反応に供される試剤の量は一般式 [16] で表される化合物1当量に対して、一般式 [5] で表される化合物で表される化合物は1~5当量であり、好ましくは1~3当量であり、塩基は1~20当量であり、好ましくは1~10当量であり、触媒は0.01~2.0当量であり、好ましくは0.01~0.5当量である。

容媒、塩基及び触媒としては、製造法2工程2と同様なものが挙げられる。 <製造法8>

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$  及びXは前記と同じ意味を示す。) (工程10)

一般式 [19] で表される化合物は、オーガニック シンセシス(Org.
 20 Synth.),第III巻,557頁(1955)又はジャーナル オブ ジアメリカン ケミカル ソサエティ(J. Amer. Chem. Soc.),第72巻,2216頁(1950)に記載の方法に準じて、一般式[18]で表される化合物とハロゲン化水素及びホルムアルデヒドもしくはパラホルムとを溶媒中、ルイス酸存在下もしくは非存在下で反応させるか、或いはジャーナ

15

20

ル オブ ジ アメリカン ケミカル ソサエティ(J. Amer. Chem. Soc.),第97巻,6155頁(1975)に記載の方法に準じて、一般式[18]で表される化合物とハロゲノメチルエーテルとを溶媒中又は無溶媒で、ルイス酸存在下で反応させる方法により製造することができる。

5 この反応は通常、反応温度-40~150℃で、10分~24時間反応させる。

反応に供される試剤の量は、一般式 [18] で表される化合物 1 当量に対して、ハロゲン化水素  $1\sim 2$  当量、ホルムアルデヒドもしくはパラホルム  $1\sim 2$  当量、ルイス酸  $1\sim 2$  当量、及びハロゲノメチルエーテル  $1\sim 2$  当量が望ましいが、反応の状況に応じて任意に変化させることができる。

ルイス酸としては、例えば四塩化チタン、塩化亜鉛、塩化アルミニウム又は 臭化亜鉛等が挙げられる。

ハロゲン化水素としては、塩化水素、臭化水素又はヨウ化水素が挙げられる。 ハロゲノメチルエーテルとしては、例えばクロロメチルメチルエーテル又は ブロモメチルメチルエーテル等が挙げられる。

溶媒としては、例えばジクロロエタン、四塩化炭素又はクロロホルム等のハロゲン化炭化水素類; ヘキサン又はヘプタン等の脂肪族炭化水素類; ジオキサン又はテトラヒドロフラン等のエーテル類; 酢酸等のカルボン酸類; 二硫化炭素; 或いはこれらの混合物が挙げられる。溶媒の使用量は、一般式 [18] で表される化合物1モルに対して溶媒0.1~20リットルの割合であり、好ましくは0.1~5リットルの割合である。

尚、一般式 [18] で表される化合物は、対応する、 $R^4$  が水素原子である化合物の当該水素原子を、製造法 2 又は 3 に準じて、 $R^4$  に変換することにより製造することができる。

次に、実施例をあげて本発明化合物の製造法を具体的に説明する。また、各実 施例で製造した又は準じて製造した本発明化合物の物性等を示す。 実施例1

1-tert-ブチルー5-ジフルオロメトキシー3-トリフルオロメチルー 1 Hーピラゾール(本発明化合物番号021)の製造 5

1-tert-ブチルー5-ヒドロキシー3-トリフルオロメチルー1H-ピ ラゾール10. 4g (50.0ミリモル) のN, Nージメチルホルムアミド50 m1溶液に、室温にて無水炭酸カリウム7.6g(55.0ミリモル)を加え た。反応溶液を攪拌しながら、80℃でクロロジフルオロメタンを反応溶液中に 過剰量導入した。原料の消失を確認した後、クロロジフルオロメタンの導入を停 止し、反応溶液を室温まで冷却した。その後反応溶液を水中に注ぎ、ジイソプロ ピルエーテルで抽出した。得られた有機層を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾 燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣を減圧蒸留し黄色液体の1-tert-ブチ ルー5-ジフルオロメトキシー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール1

0.8g(収率:83.7%)を得た。 15

> $^{1}H-NMR$ 値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.53 (1H, t, J =71.9 Hz), 6.14 (1H, s), 1.63 (9H, s)

# 実施例2

10

1-tertーブチル-5-(2, 2-ジフルオロエトキシ)-3-トリフル オロメチルー1Hーピラゾール (本発明化合物番号022) の製造 20

1-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチル-1H-ピ ラゾール50.0g(240.2ミリモル)のテトラヒドロフラン1000ml 溶液に、室温にてトリフェニルホスフィン 75.6g(288.2ミリモル)及 び2, 2-ジフルオロエタノール23.7g(288.8ミリモル)を加え、攪 拌した。さらに氷冷下反応溶液中にアゾジカルボン酸ジイソプロピル58.3 g (288.3ミリモル)を加え、5時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を 水中に注ぎジエチルエーテルにて抽出した。得られた有機層を水洗し、無水硫酸 マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣を減圧蒸留して1-ter tーブチルー5-(2,2-ジフルオロエトキシ)-3-トリフルオロメチルー 1H-ピラゾール38.2g (収率:58.4%) を得た。

沸点:98-100℃/6KPa (45mmHg) ·屈折率 (n<sup>D</sup> 2 0) : 1. 3921

 $^{1}$ H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.10(1H, tt, 10 J=3.8,54.5Hz), 5.84 (1H, s), 4.25 (2H, dt, J=3.8,13.0Hz),1.60(9H,s)

### 実施例3

1-tertーブチルー4-クロロメチルー5-(2, 2-ジフルオロエトキ シ) -3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール(本発明化合物番号141) 15 の製造

1-tert-ブチル-5-(2, 2-ジフルオロエトキシ)-3-トリフル オロメチルー1H-ピラゾール13.6g(50.0ミリモル)の酢酸50ml 溶液に、室温にてパラホルム5.0g(純度90%,150.0ミリモル)及び 塩化亜鉛20.5g(150.0ミリモル)を加え、攪拌した。さらに氷冷下反 20 応溶液中に過剰量の塩化水素を導入し、1時間攪拌した。反応終了確認後、反応 溶液を水中に注ぎジエチルエーテルにて抽出した。得られた有機層を水洗し、無 水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、ガスクロマトグラフィー 分析を行い、1-tert-ブチルー4-クロロメチルー5-(2,2-ジフル オロエトキシ) -3-トリフルオロメチルー<math>1H-ピラゾールが50.1%生成していることを確認した。

## 実施例 4

5 5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー 4ーカルボアルデヒド(本発明化合物番号281)の製造

5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾール16.6g(100.0ミリモル)のN、Nージメチルホルムアルデヒド15.4g溶液中に、0℃にてオキシ塩化リン16.2g(105.0ミリモル)を加え2温にて1時間攪拌した。さらに100℃にて1時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ25%水酸化ナトリウム溶液にてpH≥10とした後、水層を酢酸エチルにて洗浄した。得られた水層を飽和クエン酸溶液にてpH≒4とした後、酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボアルデヒド4.5g(収率:23.2%)を得た。

## 実施例5

5 - ジフルオロメトキシー1 - メチルー3 - トリフルオロメチルー1 H - ピラ 20 ゾールー4 - カルボアルデヒド(本発明化合物番号026)の製造

5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボアルデヒド1.7g(8.8ミリモル)のテトラヒドロフラン20m1溶液に、室温にて粉末状水酸化カリウム2.5g(43.8ミリモル)、テト

ラブチルアンモニウムブロミド O. 14g (0.44ミリモル)を加え攪拌した。さらに反応溶液中へ反応系内が飽和となるまでクロロジフルオロメタンを導入した。その後室温にて一夜攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、ガスクロマトグラフィー分析を行い、5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボアルデヒドが8.8%生成していることを確認した。

## 実施例 6

5

15

20

10 1,4-ジメチルー5-ヒドロキシー3-トリフルオロメチルー1H-ピラ ゾール(本発明化合物番号036)の製造

メチルヒドラジン20.9g(454.2ミリモル)のエタノール500m1 溶液に、氷冷下、4,4,4ートリフルオロー2ーメチルー3ーオキソブタン酸エチル90.0g(454.2ミリモル)を、攪拌下、10℃を超えない様に滴下した。滴下終了後、室温にて30分攪拌した。反応溶液中に濃塩酸10m1を加え、還流下2日間攪拌した。反応終了確認後、溶媒を減圧下留去した。残渣に水を加え、酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣をnーへキサンにて洗浄し白色結晶(融点:148~151℃)の1,4ージメチルー5ーヒドロキシー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール61.0g(収率:74.6%)を得た。

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):3.70(3H, d), 1.99(3H, d)

融点:148~151℃

## 実施例7

5 - ジフルオロメトキシー1, 4 - ジメチルー3 - トリフルオロメチルー1H - ピラゾール (本発明化合物番号076)の製造

- 1、4ージメチルー5ーヒドロキシー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラ ゾール78.6g(436.4ミリモル)の2ープロパノール500m1溶液中に、室温にて粉末状水酸化カリウム153.1g(2728.6ミリモル)を加え攪拌した。さらに反応溶液中へ過剰量のクロロジフルオロメタンを導入しながら、攪拌した。その後反応温度が発熱により70℃まで一旦上昇し、2時間後には室温にまで戻った。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣を蒸留し無色透明液体の5ージフルオロメトキシー1、4ージメチルー3ートリフルオロメチルー1 Hーピラゾール88.9g(収率:88.5%)を得た。
- $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.52 (1H, t, J = 71.5Hz), 3.78 (3H, s), 2.07 (3H, s)

沸点:98~100℃/6KPa (45mmHg)

屈折率 (n D 2 0):1.3921

## 実施例8

20 4ープロモメチルー 5 ージフルオロメトキシー 1 ーメチルー 3 ートリフルオロ メチルー 1 H ーピラゾール(本発明化合物番号 1 5 1)の製造

5-ジフルオロメトキシー1, 4-ジメチルー3-トリフルオロメチルー1H -ピラゾール11. 5g(50.0ミリモル)の四塩化炭素溶液50m1に、N-ブロモこはく酸イミド9.8g(55.0ミリモル)及び $\alpha$ 、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ 

イソブチロニトリル 0. 4 1 g(2. 5ミリモル)を加え攪拌下加熱環流した。 反応溶液に外部から光を 1 時間照射した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ、クロロホルムで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、4 ー ブロモメチルー 5 ー ジフルオロメトキシー 1 ー メチルー 3 ー トリフルオロメチルー 1 H ー ピラゾール 1 7. 8 g(純度:72.0%、収率:82.7%)を得た。 1 H ー NMR値(CDC  $1_3$  / TMS  $\delta$  (ppm)):6.73(1 H, t, J = 71.5 Hz),4.39(2 H, s),3.82(3 H, d) 屈折率( $n^{D}_{20}$ ):1.4401

## 10 実施例 9

15

4-ブロモメチルー5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール (本発明化合物番号151) の製造

5-ジフルオロメトキシー1, 4-ジメチルー3ートリフルオロメチルー1H ーピラゾール0.50g(2.17ミリモル)の四塩化炭素溶液5mlに、臭素0.90g(5.64ミリモル)及び過酸化ベンゾイル微量を加え攪拌下加熱環流した。反応溶液に外部から光を2時間30分照射した。反応終了後ガスクロマトグラフィー分析を行い、4ーブロモメチルー5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールが80.2%生成していることを確認した。

## 20 実施例10

2- (5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H -ピラゾール-4-イルメチル) -イソチオ尿素臭化水素酸塩 (本発明化合物番 号197) の製造 10

4-ブロモメチルー5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1Hーピラゾール19. 1g(純度75. 0%、46. 3ミリモル)のエタノール溶液30 m l に、チオ尿素3. 5g(46. 3ミリモル)を加え攪拌下1時間加熱環流した。溶媒を減圧留去し、酢酸エチル、n-ヘキサン混合溶媒にて洗浄し白色結晶(融点:130~131 $^{\circ}$ 0)の2-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4-イルメチル)ーイソチオ尿素臭化水素酸塩13. 8g(収率:77. 5%)を得た。1H-NMR値(CDC13+DMSO-146/TMS 15%)を得た。11 (12Hz), 15% 17 (19. 112 (12Hz), 110 (110 (111) 111 (111

(5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイル)ーメタンチオール(本発明化合物番号216)の製造2ー(5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1H ーピラゾールー4ーイルメチル)ーイソチオ尿素臭化水素酸塩1.00g(2.60ミリモル)のN,Nージメチルホルムアミド2m1溶液中に、無水炭酸カリウム0.43g(3.12ミリモル)及び水1m1を加え室温にて1時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけジエチルエーテルにて抽出した。得られた有機層を水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧20 留去し、(5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイル)ーメタンチオール0.66g(純度:84.9%、収率:82.4%)を得た。

 $^{1}$  H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.72(1H, t, J

=71.7Hz), 3.81 (3H, s), 3.63 (2H, s), 3.20 (1H, br)

## 実施例12

(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピ ラゾールー4ーイル) ーメタンチオール (本発明化合物番号216)の製造 4ーブロモメチルー5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール1.55g(5.00ミリモル)のエタノール10m 1溶液中に、水硫化ナトリウムn水和物0.48g(純度:70.0%、6.00ミリモル)を加え室温にて1時間攪拌した。反応終了後ガスクロマトグラフィー分析を行い、(5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイル)ーメタンチオールが40.0%生成していることを確認した。

#### 実施例13

4-クロロメチルー5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロ 15 メチルー1H-ピラゾール(本発明化合物番号123)の製造

5ージフルオロメトキシー1,4ージメチルー3ートリフルオロメチルー1H ーピラゾール11.5g(50.0ミリモル)の四塩化炭素溶液50m1に、塩 化スルフリル10.1g(75.0ミリモル)及びα、α'ーアゾビスイソブチ ロニトリル0.8g(5.0ミリモル)を加え攪拌下加熱環流した。反応溶液に 外部から光を11時間照射した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ、クロ ロホルムで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィーにて精製し、無色透明液体の4ークロロメチルー5ージフルオロメ トキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール4.8g(純度:83.4%、収率:30.3%)を得た。

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.69 (1H, t, J = 71.5Hz), 4.51 (2H, s), 3.82 (3H, s)

5 屈折率 (n<sup>D</sup>20):1.4157

#### 実施例14

4ークロロメチルー5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1H-ピラゾール(本発明化合物番号123)の製造

5ージフルオロメトキシー1, 4ージメチルー3ートリフルオロメチルー1H
10 ーピラゾール1.00g(4.35ミリモル)の四塩化炭素溶液10mlに、炭酸水素ナトリウム0.55g(6.52ミリモル)を加え攪拌下加熱環流した。反応溶液に外部から光を照射し、さらにガスクロマトグラフィーにて目的物の生成量を確認しながら塩素ガスを適量導入した。反応終了後ガスクロマトグラフィー分析を行い、4ークロロメチルー5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールが61.7%生成していることを確認した。

#### 実施例15

2- (5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H -ピラゾールー4-イルメチル) -イソチオ尿素塩酸塩(本発明化合物番号17

## 20 8)の製造

4-クロロメチルー5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール3. 7g(純度83. 4%、11. 7ミリモル)のエタノール溶液20m1に、チオ尿素0. 8g(11. 1ミリモル)を加え室温に

て一夜さらに50℃にて1時間加熱攪拌した。溶媒を減圧留去し、n-ヘキサンにて洗浄し白色結晶(融点:117~119℃)の2-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチル) -イソチオ尿素塩酸塩3.8g(収率:96.4%)を得た。

## 5 実施例16

1-エチル-5-ヒドロキシー4-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール (本発明化合物番号037) の製造

エチルヒドラジン1.2g(20.0ミリモル)のエタノール20m1溶液に、氷冷下4,4,4ートリフルオロー2ーメチルー3ーオキソブタン酸エチル10 4.4g(20.0ミリモル)を、攪拌下、反応系内温度が10℃を超えないように滴下した。滴下終了後、室温にて30分攪拌した。反応溶液中に濃塩酸1m1を加え、還流下2日間攪拌した。反応終了確認後、溶媒を減圧下留去した。残渣に水を加え、酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣をnーヘキサンにて洗浄し白色結晶(融点:150~152℃)の1ーエチルー5ーヒドロキシー4ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール2.8g(収率:71.8%)を得た。

 $^{1}$  H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.78 (1H, br), 4.06 (2H, q), 1.98 (3H, d), 1.37 (3H, t)

## 20 実施例17

5-ヒドロキシー4-メチルー1-iso-プロピルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール(本発明化合物番号038)の製造

iso-プロピルヒドラジン7.4g(100.0ミリモル)のエタノール1

00m1溶液に、氷冷下4、4、4ートリフルオロー2ーメチルー3ーオキソブタン酸エチル23.3g(純度85.0%、100.0ミリモル)を、攪拌下、反応系内温度が10℃を超えないように滴下した。滴下終了後、室温にて30分攪拌した。反応溶液中に濃塩酸1m1を加え、還流下2日間攪拌した。反応終了確認後、溶媒を減圧下留去した。残渣に水を加え、酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣をnーヘキサンにて洗浄し白色結晶(融点:150~153℃)の5ーヒドロキシー4ーメチルー1ーisoープロピルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール18.1g(収率:87.0%)を得た。

10 <sup>1</sup> H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.58 (1H, m),
1.98 (3H, d), 1.44 (6H, d)

## 実施例18

5

15

20

5 ージフルオロメトキシー4 ーメチルー1 ー i s o ープロピルー3 ートリフル オロメチルー1 Hーピラゾール (本発明化合物番号084) の製造

5ーヒドロキシー4ーメチルー1ーisoープロピルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール17.1g(82.1ミリモル)の2ープロパノール100m1溶液中に、室温にて粉末状水酸化カリウム23.0g(410.7ミリモル)を加え攪拌した。さらに反応溶液中へ過剰量のクロロジフルオロメタンを導入しながら、攪拌した。その後反応温度が発熱により70℃まで一旦上昇し、2時間後には室温にまで戻った。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣を蒸留し無色透明液体の5ージフルオロメトキシー4ーメチルー1ーisoープロピルー3ートリフルオロメチ

10

ル-1H-ピラゾール15.9g (収率:75.0%) を得た。  $^{1}$  H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.52 (1H, t, J =71.5Hz), 4.58 (1H, m), 1.98 (3H, d), 1.44 (6H, d)

沸点:84~86℃/3.33KPa (25mmHg) 屈折率 (n<sup>D</sup><sub>20</sub>):1.3974 実施例19

4ーブロモメチルー5ージフルオロメトキシー1ーisoープロピルー3ート リフルオロメチルー1Hーピラゾール(本発明化合物番号158)の製造

- 5-ジフルオロメトキシー4-メチル-1-iso-プロピルー3-トリフル オロメチルー1H-ピラゾール10.3g(40.0ミリモル)の四塩化炭素溶 液40mlに、N-ブロモコハク酸イミド7.8g (44.0ミリモル) 及び lpha、lpha'ーアゾビスイソブチロニトリル lpha. lpha lpha (2.0ミリモル)を加え攪拌 下加熱環流した。反応溶液に外部から光を1時間照射した。反応終了確認後、反 応溶液を水中にあけ、クロロホルムで抽出した。得られた有機層を水及び食塩水 15 で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣 をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し無色透明液体の4ーブロモメ チルー5ージフルオロメトキシー1ーiso-プロピルー3ートリフルオロメチ ルー1H-ピラゾール5.5g (収率:40.7%) を得た。
- $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.72 (1H, t, J 20 =71.9Hz), 4.62 (1H, m), 4.40 (2H, s), 1.47 (6H, d, J=6.8Hz)

屈折率 (n<sup>D</sup><sub>20</sub>):1.4383

#### 実施例20

- 1, 4ージメチルー5ー(2, 2, 2ートリフルオロエトキシ)ー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール(本発明化合物番号079)の製造
- 1,4ージメチルー5ーヒドロキシー3ートリフルオロメチルー1Hーピラ

  ゾール4.4g(24.4ミリモル)のN,Nージメチルホルムアミド50ml
  溶液中に、室温にて無水炭酸カリウム5.1g(36.6ミリモル)及び2,
  2,2ートリフルオロエチルトリフルオロメタンスルホネート6.3g(26.8ミリモル)を加え3時間室温にて攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、淡黄色液体の1,4ージメチルー5ー(2,2,2ートリフルオロエトキシ)ー3ートリフルオロメ
  - チルー1Hーピラゾール6. 1g(収率:95.  $3%)を得た。 <math>^1$ H-NMR値(CDC13/TMS $\delta$ (ppm)):4. 41(2H, q),
    - 3. 74 (3H, d), 2. 08 (3H, d)
- 15 屈折率 (n<sup>D</sup> 2 0) : 1. 3872

## 実施例21

- 5-(2, 2-ジフルオロエトキシ)-1, 4-ジメチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール(本発明化合物番号078)の製造
- 1, 4ージメチルー5ーヒドロキシー3ートリフルオロメチルー1Hーピラ ブール9.0g(50.0ミリモル)のテトラヒドロフラン50ml溶液中に、 室温にてトリフェニルホスフィン14.4g(55.0ミリモル)及び2,2ージフルオロエタノール4.5g(55.0ミリモル)を加え攪拌した。さらに氷 冷下にてアゾジカルボン酸ジイソプロピル12.3g(60.0ミリモル)を加

えー夜室温にて攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水中にあけ酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、淡黄色液体の1,4ージメチルー5ー(2,2ージフルオロエトキシ)-3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール6.8g(収率:55.7%)を得た。

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.05 (1H, tt, J=3.8,54.3Hz), 4.27 (2H, dt, J=3.8,13.5Hz), 3.73 (3H, s), 2.08 (3H, d)

10 屈折率 (n D 2 0) : 1. 4070

#### 実施例22

5-ヒドロキシー4-メチルー1-n-プロピルー3-トリフルオロメチルー1 H-ピラゾール (本発明化合物番号039)

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)):8.75 (1H, b 15 r), 3.94 (2H, t), 1.96 (3H, d), 1.77 (2H, m), 0.88 (3H, t)

融点:13,3~134℃"

## 実施例23

1-n-ブチル-5-ヒドロキシー4-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール(本発明化合物番号040)

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)):
7. 73 (1H, br), 3. 98 (2H, t), 1. 97 (3H, d), 1. 74 (2H, m), 1. 29 (2H, m), 0. 91 (3H, t)

融点:132~133℃"

#### 実施例 2 4

1-tertーブチルー5-ヒドロキシー4-メチルー3-トリフルオロメチル -1H-ピラゾール(本発明化合物番号043)

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl  $_{3}$ /TMS  $^{3}$  (ppm)):5.45(1H, b r),1.97(3H, d),1.60(9H, s)

融点:159~160℃

## 実施例25

5ージフルオロメトキシー4ーメチルー1ーエチルー3ートリフルオロメチルー

10 1 H - ピラゾール (本発明化合物番号080)

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.49 (1H, t, J = 71.9Hz), 4.10 (2H, q), 2.07 (3H, d), 1.42 (3H, t)

沸点:88~91℃/3.73KPa (28mmHg)

15 屈折率 (n 2 0):1.3971

## 実施例26

1-エチル-4-メチル-5-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール(本発明化合物番号083)

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):4.42(2H, q),

20 4.07 (2H, q), 2.09 (3H, d), 1.41 (3H, t)

### 実施例27

4-メチルー1-isoープロピルー5-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -3-トリフルオロメチルー1 H-ピラゾール(本発明化合物番号087)

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.55 (1H, m),
4.41 (2H, q), 2.08 (3H, d), 1.45 (6H, d)
実施例 28

4-メチル-1-n-プロピル-5-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-

5 3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾール(本発明化合物番号090)

 $^{1}$  H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):4.41(2H, q),

3. 97 (2H, t), 2. 09 (3H, d), 1. 84 (2H, m), 0. 9

1 (3H, t)

## 実施例 2 9

10 1-n-ブチル-4-メチル-5-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-3
-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール(本発明化合物番号093)

<sup>1</sup> H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS δ(ppm)):4.41(2H,q),
4.00(2H,t),2.09(3H,d),1.80(2H,m),1.3
0(2H,m),0.93(3H,t)

#### 15 実施例30

#### 20 実施例31

4-エチル-1-メチル-5-ジフルオロメトキシー3-トリフルオロメチルー 1H-ピラゾール (本発明化合物番号105)

 $^{1}$  H-NMR値(CDCl $_{3}$ /TMS  $\delta$  (ppm)):6.50 (1H, t, J

=71.7Hz), 3.78 (3H, s), 2.51 (2H, q), 1.15 (3H, t)

屈折率 (n D 2 0) : 1. 4021

実施例32

5 4ーブロモメチルー1ーメチルー5ー(2,2ージフルオロエトキシ)ー3ート リフルオロメチルー1Hーピラゾール(本発明化合物番号153)

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.11 (1H, tt, J=3.5, 54.2Hz), 4.52 (2H, dt, J=3.5, 13.5Hz), 4.43 (2H, s), 3.76 (3H, s)

10 屈折率 (n 2 0):1.4490

実施例33

4ープロモメチルー1ーメチルー5ー(2, 2, 2ートリフルオロエトキシ)ー 3ートリフルオロメチルー1 Hー $^{\text{H}}$ ラゾール(本発明化合物番号1 5 4)  $^{1}$  H-NMR値(CDC 1  $_{8}$  / TMS  $\delta$  (p p m)):4. 6 8 (2 H, q),

15 4.41 (2H, s), 3.77 (3H, s)

屈折率 (n<sup>D</sup><sub>20</sub>):1.3872

実施例34

4ーブロモメチルー5ージフルオロメトキシー1-エチルー3ートリフルオロメ チルー1H-ピラゾール(本発明化合物番号155)

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.73 (1H, t, J = 71.7Hz), 4.40 (2H, s), 4.13 (2H, q), 1.46 (3H, t)

実施例35

4-ブロモメチルー1-tert-ブチルー5-(2,2-ジフルオロエトキシ) -3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾール(本発明化合物番号168)  $^1$  H-NMR値(CDC $1_3$ /TMS  $\delta$  (ppm)): 6.15(1H, tt, J=3.7, 54.1Hz), 4.56(2H, dt, J=3.7, 13.4Hz), 4.45(2H, s), 1.60(9H, s)

実施例36

2-(5-(2, 2-ジフルオロエトキシ) -1-メチル-3-トリフルオロメ チル-1H-ピラゾール-4-イルメチル) -イソチオ尿素臭化水素酸塩(本発 明化合物番号199)

 $_{10}$   $_{1}$   $_{H-NMR}$   $_{I}$   $_{H-NMR}$   $_{I}$   $_{I}$ 

実施例37

2-(5-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -1-メチル-3-トリフル 15 オロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメチル) -イソチオ尿素臭化水素酸塩 (本発明化合物番号200)

融点:128~131℃

実施例38

2- (5-ジフルオロメトキシー1-エチルー3-トリフルオロメチルー1H-20 ピラゾールー4-イルメチル) -イソチオ尿素臭化水素酸塩 (本発明化合物番号 201)

融点:139~141℃

実施例39

2- (5-ジフルオロメトキシー1-iso-プロピルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチル) -イソチオ尿素臭化水素酸塩(本発明化合物番号204)

融点:146~148℃

## 5 実施例40

(5-ジフルオロメトキシー1-iso-プロピルー3-トリフルオロメチルー 1H-ピラゾールー4-イル) -メタンチオール (本発明化合物番号223) <sup>1</sup> H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub> /TMS δ (ppm)):6.72 (1H, t, J =72.2Hz), 4.60 (1H, m), 3.62 (2H, s), 1.46

上記の化合物以外にも、以下の表に化合物番号で示す化合物については、物性 値や機器分析データを確認した。

表12

化合物番号	物性値又はNMRデータ
0 3 7	融点:150~152℃
038	融点:150~153℃
151	$^{1}$ H-NMR値(CDCl <sub>3</sub> /TMS $\delta$ (ppm)): 6.73 (1)
	H, t, $J = 71.5 Hz$ ), 4.39 (2H, s), 3.82 (3)
	H, d)
	屈折率(n <sup>D</sup> 20):1.4401
178	融点:117~119℃
197	融点:130~131℃

以下に、一般式 [I] で表される本発明化合物を中間体として用いた、イソオキサゾリン誘導体(特開2002-308857号記載)の製造、及び当該イソオキサゾリン誘導体の有する除草作用を説明する。

まず、一般式 [I] で表される本発明化合物(ピラゾール誘導体又はその塩)を用いた、イソオキサゾリン誘導体(特開2002-308857号記載)の製造について説明する。

5

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^7$ 、 $R^8$  及びXは前記と同じ意味を示し、 $R^9$  及び $R^{1\,0}$  は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基又はシクロアルキルアルキル基を示すか、或いは $R^9$  と $R^{1\,0}$  とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共にC3~C7のスピロ環を示し、 $R^{1\,1}$  及び $R^{1\,2}$  は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基又はシクロアルキル基を示すか、或いは $R^{1\,1}$  と $R^{1\,2}$  とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共に $R^{1\,2}$  とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共に $R^{1\,2}$  とが一緒になって、これらの結合した炭素原子と共に $R^{1\,2}$  との場を示し、さらに $R^9$ 、 $R^{1\,0}$ 、 $R^{1\,1}$  及び $R^{1\,2}$  はこれらの結合した炭素原

子と共に5~8員環を形成することもできる。R<sup>13</sup> はC1~C4アルキル基、置換されていてもよいフェニル基又は置換されていてもよいベンジル基を示し、L はハロゲン原子、C1~C4アルキルスルホニル基、置換されていてもよいフェニルスルホニル基又は置換されていてもよいベンジルスルホニル基等の脱離基を示す。)

以下、上記の、イソオキサゾリン誘導体の製造方法を、各工程毎に説明する。 (工程11)

一般式 [23] で表されるスルフィド誘導体は、一般式 [20] で表される化合物と、一般式 [21] で示される水硫化ナトリウム水和物を、溶媒中又は溶媒 の非存在下で(好ましくは適当な溶媒中)、塩基の存在下反応させることにより一般式 [22] で表されるメルカプタンの塩を反応系内で製造した後、メルカプタンの塩 [22] を単離することなく、本発明化合物である一般式 [10] で表されるハロゲン誘導体と反応させること(場合によっては不活性ガス雰囲気下で行うか又は還元剤を添加することができる)によって製造することができる。

## 15 (工程12)

5

一般式[25]で表されるスルホキシド誘導体は、一般式[23]で表されるスルフィド誘導体と酸化剤を、適当な溶媒中で反応させることにより製造することができる。

## (工程13)

20 一般式 [26] で表されるスルホン誘導体は、一般式 [25] で表されるスル ホキシド誘導体と酸化剤を、適当な溶媒中で反応させることにより製造すること ができる。

#### (工程14)

一般式 [26] で表されるスルホン誘導体は、適当な溶媒中、一般式 [23] で表されるスルフィド誘導体と好適な酸化剤の量により、一般式 [25] で表されるスルホキシド誘導体を単離することなく製造することができる。

#### (工程15)

5 一般式 [23] で示されるスルフィド誘導体は、一般式 [24] で表される化合物に対し、本発明化合物である一般式 [13] で示されるメルカプタン誘導体を、溶媒中又は溶媒の非存在下で(好ましくは適当な溶媒中)、塩基の存在下で反応させること(場合によっては不活性ガス雰囲気下で行うか又は還元剤を添加することができる)により製造することができる。本発明化合物である一般式 [13] で示されるメルカプタン誘導体は、製造法5工程6又は工程7の記載の方法により反応系内において製造し使用することもできる。

次に、参考例をあげて、一般式 [I] で表される本発明化合物を用いた、イソオキサゾリン誘導体(特開2002-308857号記載)の製造を具体的に説明する。

#### 15 <参考例1>

3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリンの 製造

1) 3-エタンスルホニル-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン6.7
 20 g(35.0ミリモル)のN, N-ジメチルホルムアミド50m1溶液に、水硫化ナトリウム5.6g(純度70%、70.0ミリモル)を加え,室温にて1時間攪拌した。その後炭酸カリウム4.8g(35.0ミリモル)及び4-プロモメチル-5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピ

ラゾール10.8g(35.0ミリモル)を加え室温にて一夜攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を水および食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し白色結晶(融点:39~40℃)の3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチルチオ)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン7.3g(収率57.9%)を得た。

5

10

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.72 (1H, t, J = 72.0Hz), 4.19 (2H, s), 3.81 (3H, s), 2.78 (2H, s), 1.42 (6H, s)

- 2) 2- (5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメチル) -イソチオ尿素臭化水素酸塩1.93g (5.00ミリモル) のエタノール10m1溶液中に、水酸化ナトリウム0.48g (12.00ミリモル) 及び水10m1を加え室温にて30分間攪拌した。そこへ3-クロロー5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン0.67g (5.00ミリモル)を室温にて加え、さらに還流下12時間攪拌した。反応終了確認後、溶媒を減圧下留去した。得られた残渣を水中にあけ、酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4ーイルメチルチオ)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン1.02g(収率56.7%)を得た。
  - 3) 2-(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルー

5

1Hーピラゾールー4ーイルメチル)ーイソチオ尿素臭化水素酸塩1.93g (5.00ミリモル)のエタノール10m1溶液中に、無水炭酸カリウム0.8 3g (6.00ミリモル)及び水5m1を加え室温にて30分間攪拌した。そこへ3ーエタンスルホニルー5,5ージメチルー2ーイソオキサゾリン0.95g (5.00ミリモル)のN,Nージメチルホルムアミド5m1溶液及び無水炭酸カリウム0.83g (6.00ミリモル)を室温にて加え、さらに50℃にて3時間攪拌した。反応終了確認後、溶媒を減圧下留去した。得られた残渣を水中にあけ、酢酸エチルにて抽出した。得られた有機層を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ

10 フィーにて精製し3-(5-i)フルオロメトキシー1-iメチルー3-iトリフルオロメチルー1H-iプブールー4-iイルメチルチオ1-i0、5-i0、5-i0、5-i0、1+i0 (1+i0 ) 1+i0 (1+i

## <参考例2>

3-(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-15 ピラゾール-4-イルメタンスルフィニル)-5,5-ジメチル-2-イソオキサ ゾリンの製造

3ー(5ージフルオロメトキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルー1Hーピラゾールー4ーイルメチルチオ)ー5,5ージメチルー2ーイソオキサゾリン6.2g(17.3ミリモル)のクロロホルム40m1溶液に、氷冷下、mークロロ過安息香酸3.4g(純度70%,13.8ミリモル)を加え1時間攪拌した。その後、さらに室温で3時間攪拌した。反応終了確認後、反応溶液を水に注ぎクロロホルムで抽出した。得られた有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、水及び食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウ

ムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた固体をn-へキサンで洗浄し,白色粉末 (融点: $112\sim114$ °C) の3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチル-3-トリフルオロメチル-1 H-ピラゾール-4-イルメタンスルフィニル) -5,5-ジメチル-2-イソオキサゾリン4.1g(収率63.2%)を得た。

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.95 (1H, q, J = 69.5, 74.4Hz), 4.16 (2H, s), 3.85 (3H, s), 3.11 (2H, q, J=17.2Hz), 1.52 (6H, d, J=5.5Hz)

## <参考例3>

5

15

20

3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾ リンの製造

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J = 71.9Hz), 4.60 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.11 (2H, s), 1.52 (6H, s)

## <参考例4>

5 3-(5-ジフルオロメトキシー1-エチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾ リン

融点:98~100℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J  $_{10}$  = 72.0Hz), 4.60 (2H, s), 4.19 (2H, q), 3.11 (2 H, s), 1.51 (6H, s), 1.49 (3H, s)

## <参考例5>

 $3-(5-\Im 7 \nu \lambda + 2 \nu - 1 - i s o - 7 \nu \nu - 3 - 1 \nu \nu \lambda + 2 \nu$ 

屈折率 (n<sup>D</sup>20):1.4621

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J = 72.1Hz), 4.70 (1H, m), 4.60 (2H, s), 3.10 (2H, s), 1.52 (6H, s), 1.49 (6H, s)

#### 20 <参考例6>

15

3-(5-ジフルオロメトキシー1-n-プロピルー3-トリフルオロメチルー 1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソオ キサゾリン 屈折率 (n<sup>p</sup><sub>20</sub>):1.4629

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.82 (1H, t, J = 71.7Hz), 4.60 (2H, s), 4.09 (2H, t), 3.10 (2H, s), 1.92 (2H, m), 1.52 (6H, s), 0.94 (3

5 H, t)

<参考例7>

3-(1-iso-ブチルー5-ジフルオロメトキシー3-トリフルオロメチル -1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5,5-ジメチルー2-イソ オキサゾリン

In Eff率(n<sup>D</sup><sub>20</sub>):1.4601

IH-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS δ(ppm)):6.81(1H, t, J)

=71.7Hz), 4.60(2H, s), 3.94(2H, d), 3.10

(2H, s), 2.30(1H, m), 1.51(6H, m), 0.92(6

H, d)

15 〈参考例8〉

3-(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメタンスルホニル)-5-エチル-5-メチル-2-イソオ キサゾリン

融点:77~78℃

 $^{1}$  H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS  $^{\delta}$  (ppm)):6.83(1H, t, J = 71.9Hz),4.60(2H, s),3.88(3H, s),3.09(2H, ABq, J=17.4Hz, $^{\Delta}$   $^{\nu}$  = 46.7Hz),1.78(2H, q),1.47(3H, s),0.98(3H, t)

## <参考例9>

3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5-メチルー5-シクロプロピルー2 -イソオキサブリン

5 融点:96~98℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J = 71.9Hz), 4.59 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.13 (2H, ABq, J=17.3Hz,  $\Delta \nu$ =53.4Hz), 1.48 (3H, s), 1.14 (1H, m), 0.36~0.58 (4H, m)

10 <参考例10>

7-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5-オキサー6-アザスピロ[3. 4]-6-オクテン

融点:149~151℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.83 (1H, t, J = 71.9Hz), 4.58 (2H, s), 3.87 (3H, s), 3.40 (2H, s), 2.62 (2H, m), 2.27 (2H, m), 1.91 (1 H, m), 1.67 (1H, m)

<参考例11>

20 3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-2-イソオキサゾリン "

融点:115~117℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.83 (1H, t, J

=71.7Hz), 4.66(2H, t), 4.61(2H, s), 3.88 (3H, s), 3.37(2H, t)

## <参考例12>

6-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-5 ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-4-オキサー5-アザスピロ[2.4]-5-ヘプテン

融点:125~126℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J = 71.9Hz), 4.61 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.42 (2H, s), 1.31 (2H, t), 0.91 (2H, t)

<参考例13>

10

3-[1-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イル)-エタンスルホニル]-5,5-ジメチルー2ーイソオキサゾリン

15 屈折率 (n<sup>D</sup>20):1.4657

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.92 (1H, m),
4.83 (1H, q), 3.88 (3H, s), 3.07 (2H, d), 1.8
3 (3H, d), 1.50 (6H, d)

<参考例14>

20 3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルーメタンスルホニル)-3a, 4, 5, 6, 7, 7a-ヘキ サヒドローベンゾ [d] イソオキサゾール

融点:97~98℃

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.84 (1H, t, J =72.0Hz), 4.69 (1H, m), 4.61 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.48 (1H, m), 1.26~2.17 (9H, m) <参考例15>

5 3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4ーイルメタンスルホニル)-5-メチルー2ーイソオキサゾリン融点:106~107℃

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.83 (1H, t, J =71.9Hz), 5.05 (1H, m), 4.60 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.44 (1H, dd), 2.96 (1H, dd), 1.48 (3H, d)

## <参考例16>

15

20

3-(5-i)フルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-5-iso-プロピルー2-イソオキサゾリン

融点:85~86℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.83 (1H, t, J = 71.7Hz), 4.67 (1H, m), 4.59 (2H, s), 3.88 (3H, s), 3.30 (1H, dd), 3.08 (1H, dd), 1.97 (1H, m), 0.98 (6H, dd)

#### <参考例17>

3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-4,5,5-トリメチルー2-イソオ キサゾリン

5

屈折率 (n D 2 0) : 1.4646

<sup>1</sup> H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.84 (1H, t, J =71.9Hz), 4.61 (2H, q), 3.88 (3H, s), 3.36 (1H, q), 1.44 (3H, s), 1.38 (3H, s), 1.30 (3 H, d)

## <参考例18>

3-(5-ジフルオロメトキシー1-メチルー3-トリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル)-4-メチルー2-イソオキサゾリン

In alpha (n<sup>D</sup> 20): 1.4673

In H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 6.83 (1H, t, J)

=71.8Hz), 4.71 (1H, t), 4.62 (2H, q), 4.25

(1H, t), 3.88 (3H, s), 3.81 (1H, m), 1.44 (3H, d)

## 15 <参考例19>

3- [1-(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルー 1H-ピラゾール-4-イル)-プロパン-1-スルホニル] -5,5-ジメチル -2-イソオキサゾリン

屈折率 (n<sup>D</sup> 2 0) : 1.4669

 $^{1}$  H-NMR値(CDCl<sub>s</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.91 (1H, t, J = 72.9Hz), 4.60 (1H, q), 3.89 (3H, s), 3.05 (2H, d), 2.30 (2H, m), 1.49 (6H, d), 0.94 (3 H, t)

## <参考例20>

3-[5-(2, 2, 2-h)]フルオロエトキシ) -1-xチルー3-hリフルオロメチルー1 H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル] -5, 5-ジメチルー2-イソオキサゾリン

5 融点:93~95℃

<sup>1</sup> H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.68(2H, q),
4.59(2H, s), 3.84(3H, s), 3.12(2H, s), 1.5
3 (6H, s)

## <参考例21>

融点:89~91℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.11 (1H, tt, J=3.5,54.4Hz),4.58 (2H,s),4.48 (2H,dt, J=3.7,15.3Hz),3.88 (3H,s),3.11 (2H,s),

## <参考例22>

3-[1-tert-ブチル-5-(2, 2-ジフルオロエトキシ)-3-ト
20 リフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメタンスルホニル]-5, 5-ジメチル-2-イソオキサゾリン

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.14 (1H, tt, J=3.9, 54.4Hz), 4.61 (2H, s), 4.54 (2H, dt,

J=3. 6, 13. 4Hz), 3. 08 (2H, s), 1. 63 (9H, s),
1. 51 (6H, s)

#### <参考例23>

3-[5-(2,2-i)]フルオロエトキシ)-1-iso-プロピルー3-ト リフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル]-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン

融点:88~89℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.11 (1H, tt, J=3.4,54.6Hz),4.58~4.65 (3H, m),4.47 (2 H, dt, J=3.7,13.4Hz),3.10 (2H,s),1.52 (6 H,s),1.46 (6H,d)

## <参考例24>

15

3-[1-x+y-5-(2,2-i)] -3-i -3-i

屈折率 (n D 2 0): 1.4687

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 6.11 (1H, tt, J=3. 7, 54.5Hz), 4.58 (2H, s), 4.48 (2H, dt, J=3. 7, 13.4Hz), 4.16 (2H, q), 3.10 (2H, s),

20 1. 52 (6H, s), 1. 47 (3H, t)

## <参考例25>

3-[5-(2,2-i)] ルオロメチルー1H-i ラゾールー4-i ルオロメチルー1H-i ラブールー4-i ルメタンスルホニル1-i 1-i 1-i

チルー2ーイソオキサゾリン

屈折率 (n<sup>D</sup>20):1.4658

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)):6.11 (1H, tt,

J=3. 7, 54. 3Hz), 4. 59 (2H, s), 4. 47 (2H, dt,

J = 3.7, 13.5 Hz, 4.04 (2H, t), 3.09 (2H, t),

1. 90 (2H, m), 1. 52 (6H, s), 0. 94 (3H, t)

<参考例26>

3-[5-(2,2,2-h)]フルオロエトキシ)-1-iso-プロピルー 3-hリフルオロメチルー1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル]ー

10 5, 5ージメチルー2ーイソオキサゾリン

融点:109~110℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 4.55~4.70 (5 H, m), 3.11 (2H, s), 1.52 (6H, s), 1.49 (6H, d)

15 <参考例27>

3-[5-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -1-n-プロピル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イルメタンスルホニル] -5, 5

融点:49~51℃

<参考例28>

3-[1-n-ブチル-5-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-3-トリフルオロメチルー<math>1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル]-5,5-ジメチルー2-イソオキサゾリン

屈折率 (n<sup>D</sup> 2 0) : 1.4533

5 <sup>1</sup> H-NMR値 (CDC1<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.67 (2H, q),
4.59 (2H, s), 4.07 (2H, t), 3.10 (2H, s), 1.8
4 (2H, m), 1.52 (6H, s), 1.35 (2H, m), 0.95 (3H, t)

<参考例29>

3-[1-x+y-5-(2,2,2-h)] 3-[1-x+y-5-(2,2,2-h)] y=10 y=10

融点:84~86℃

<sup>1</sup> H-NMR値(CDCl<sub>3</sub>/TMS δ (ppm)): 4.68(2H, q),

15 4.59(2H, s), 4.14(2H, q), 3.11(2H, s), 1.5

2 (6H, s), 1.47(3H, t)

<参考例30>

3-[1-tert-ブチルー5-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-3-トリフルオロメチルー<math>1H-ピラゾールー4-イルメタンスルホニル]-

20 5, 5ージメチルー2ーイソオキサブリン・

融点:91~92℃

 $^{1}$  H-NMR値 (CDCl<sub>3</sub>/TMS  $\delta$  (ppm)): 4.77(2H, q), 4.60(2H, s), 3.11(2H, s), 1.63(9H, s), 1.5

2 (6H, s)

5

10

15

20

続いて、一般式[I]で表されるピラゾール誘導体又はその塩(本発明化合物)を用いることにより製造しうる、一般式[26]で示される化合物(特開2002-308857号記載のイソオキサゾリン誘導体)の示す除草作用について説明する。

一般式[26]で示される化合物 (特開2002-308857号記載のイソオキサゾリン誘導体)を除草剤として使用するには、それ自体で用いてもよいが、製剤化に一般的に用いられる担体、界面活性剤、分散剤または補助剤等を配合して、粉剤、水和剤、乳剤、フロアブル剤、微粒剤または粒剤等に製剤して使用することもできる。

製剤化に際して用いられる担体としては、例えばタルク、ベントナイト、クレー、カオリン、珪藻土、ホワイトカーボン、バーミキュライト、炭酸カルシウム、消石灰、珪砂、硫安、尿素等の固体担体、イソプロピルアルコール、キシレン、シクロへキサン、メチルナフタレン等の液体担体等があげられる。

界面活性剤及び分散剤としては、例えばアルキルベンゼンスルホン酸金属塩、ジナフチルメタンジスルホン酸金属塩、アルコール硫酸エステル塩、アルキルアリールスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、ポリオキシエチレングリコールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノアルキレート等があげられる。補助剤としては、例えばカルボキシメチルセルロース、ポリエチレングリコール、アラビアゴム等があげられる。使用に際しては適当な濃度に希釈して散布するかまたは直接施用する。

一般式[26]で示される化合物は茎葉散布、土壌施用または水面施用等により

10

使用することができる。有効成分の配合割合については必要に応じて適宜選ばれるが、粉剤または粒剤とする場合は0.01~10%(重量)、好ましくは0.05~5%(重量)の範囲から適宜選ぶのがよい。乳剤及び水和剤とする場合は1~50%(重量)、好ましくは5~30%(重量)の範囲から適宜選ぶのがよい。また、フロアブル剤とする場合は1~40%(重量)、好ましくは5~30%(重量)の範囲から適宜選ぶのがよい。

一般式[26]で示される化合物の除草剤としての施用量は、使用される化合物の種類、対象雑草、発生傾向、環境条件ならびに使用する剤型等によってかわるが、粉剤及び粒剤のようにそのまま使用する場合は、有効成分として $1 \sim 0$  タール当り $1 \sim 0$  の  $0 \sim 0$  以来しくは $1 \sim 0$  の  $0 \sim 0$  の  $0 \sim 0$  の  $0 \sim 0$  以来しくは $1 \sim 0$  の  $0 \sim 0$  の

また、一般式[26]で示される化合物は必要に応じて殺虫剤、殺菌剤、他の除 15 草剤、植物生長調節剤、肥料等と混用してもよい。

次に代表的な製剤例をあげて製剤方法を具体的に説明する。化合物、添加剤の 種類及び配合比率は、これのみに限定されることなく広い範囲で変更可能であ る。以下の説明において「部」は重量部を意味する。

# <参考製剤例1> 水和剤

20 一般式[26]で示される化合物の10部にポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテルの0.5部、βーナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩の0.5部、珪藻土の20部、クレーの69部を混合粉砕し、水和剤を得た。

粗粉砕した一般式[26]で示される化合物の20部を水69部に分散させ、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル硫酸塩4部、エチレングリコール7部を加えるとともにシリコーンAF-118N(旭化成工業株式会社製)を製剤に対し200ppm加え、高速攪拌機で30分間混合した後、湿式粉砕機で粉砕しフロアブル剤を得た。

### <参考製剤例3> 乳剤

一般式[26]で示される化合物の30部にキシレンとイソホロンの等量混合物60部、界面活性剤ポリオキシエチレンソルビタンアルキレート、ポリオキシエチレンアルキルアリールポリマー及びアルキルアリールスルホネートの混合物の10部を加え、これらをよくかきまぜることによって乳剤を得た。

## <参考製剤例4> 粒剤

10

15

一般式[26]で示される化合物の10部、タルクとベントナイトを1:3の割合の混合した増量剤の80部、ホワイトカーボンの5部、界面活性剤ポリオキシエチレンソルビタンアルキレート、ポリオキシエチレンアルキルアリールポリマー及びアルキルアリールスルホネートの混合物の5部に水10部を加え、よく練ってペースト状としたものを直径0.7mmのふるい穴から押し出して乾燥した後に0.5~1mmの長さに切断し、粒剤を得た。

次に試験例をあげて一般式[26]で示される化合物の奏する効果を説明する。 <参考試験例1> 水田土壌処理による除草効果試験

20 100cm²プラスチックポットに水田土壌を充填し、代掻後、タイヌビエ、コナギの種子を播種し、水深3cmに湛水した。翌日、製剤例1に準じて調製した水和剤を水で希釈し、水面滴下した。施用量は、有効成分を、1へクタール当り250g又は1000gとした。その後、温室内で育成し、処理後21日目に、

表13の基準に従って除草効果を調査した。結果を表14に示す。

表13

指数	除草効果(生育抑制程度)及び薬害
5	90%以上の抑制の除草効果、薬害
4	70%以上90%未満の除草効果、薬害
3	50%以上70%未満の除草効果、薬害
2	30%以上50%未満の除草効果、薬害
1	10%以上30%未満の除草効果、薬害
0 -	0%以上10%未満の除草効果、薬害

表14

参考例番号	薬量(g a.i. /ha)	タイヌピエ	コナキ・
5	1000	5	5
8	1000	5	5
1 0	2 5 0	5	5
1 1	2 5 0	5	5
1 5	1000	5	5
1 8	2 5 0	5	5
2 0	1000	5	5
2 1	1000	5	5

5

10

# <参考試験例2> 畑地土壌処理による除草効果試験

 $80\,\mathrm{cm^2}$ プラスチックポットに畑土壌を充填し、イヌビエ、エノコログサの種子を播種して覆土した。製剤例1に準じて調製した水和剤を水で希釈し、1へクタール当り有効成分が $250\,\mathrm{g}$ 又は $1000\,\mathrm{g}$ になる様に、1へクタール当り $1000\,\mathrm{g}$ になった、その後、温室内で育成し、

処理21日目に、表13の基準に従って、除草効果を調査した。結果を表15に 示す。

表15

参考例番号	薬量(g a.i. /ha)	イヌヒ゛エ	エノコロク゛サ
3	1000	5	5
4	1000	5	5
5	1000	5	5
8	1000	5	5
1 5	1000	5.	5
1 7	1000	5	5
2 0	2 5 0	5	5
2 4	2 5 0	5	5
			<u> </u>

## 5 <参考試験例3> 畑地茎葉処理による除草効果試験

80cm²プラスチックポットに砂を充填し、イヌビエ、エノコログサの種子を 播種し、温室内で2週間育成後、製剤例1に準じて調製した水和剤を水に希釈 し、1へクタール当り有効成分が250g又は1000gになる様に、1へク タール当り10001を小型噴霧器で植物体の上方から全体に茎葉散布処理し た。その後、温室内で育成し、処理14日目に、表13の基準に従って、除草効 果を調査した。結果を表16に示す。

表16

参考例番号	薬量(g a.i. /ha)	イヌヒ゛エ	エノコロク゛サ
3	1 0 0 0	5	5
6	2 5 0	5	4
7	250	5	4
9	2 5 0	5	4
1 3	1000	5	4
1 4	1000	5	4
2 3	2 5 0	5	4
2 4	2 5 0	5	4

#### 産業上の利用分野

11

10

本発明により、優れた除草作用を有するイソオキサゾリン誘導体(特開2002-308857号記載)の製造中間体として有用な、一般式[I]で表されるピラゾール誘導体又はその塩が提供される。本発明化合物を製造中間体として利用することによって、優れた除草作用を有する前記特開2002-308857号記載のイソオキサゾリン誘導体を、より短い工程(より少ない工程数)で、全工程収率良く、簡便に製造することが可能となるので、本発明化合物の価値は高

#### 請求の範囲

1. 一般式 [I]

5

$$\begin{array}{c}
R^2 \\
N \\
N \\
N \\
R^4O
\end{array}$$

 ${$  (式中、 $R^1$  は、 $C1\sim C6$  アルキル基を示し、 $R^2$  は、 $C1\sim C3$  ハロアルキル基示し、 $R^3$  は、水素原子、下記置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよい $C1\sim C3$  アルキル基又はホルミル基を示し、 $R^4$  は、水素原子又は $C1\sim C3$  ハロアルキル基を示す(但し、 $R^3$  が水素原子又はホルミル基である場合、 $R^4$  は $C1\sim C3$  ハロアルキル基を示し、 $R^3$  が下記置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよい $C1\sim C3$  アルキル基である場合、 $R^4$  は水素原子又は $C1\sim C3$  ハロアルキル基を示す。 $\}$ 

10 で表されるピラゾール誘導体又はその塩。

## 「置換基群α」

ハロゲン原子、-SH基、-SC (=NH) NH<sub>2</sub>基

- 2. R<sup>4</sup> がC1~C3ハロアルキル基である請求項1記載のピラゾール誘導体又はその塩。
- 3.  $R^3$  が $C1\sim C3$ アルキル基であり、 $R^4$  が水素原子である請求項1記載のピラゾール誘導体又はその塩。
  - 4.  $R^{s}$  が置換基群  $\alpha$  から選ばれる 1 個以上の置換基で置換されていてもよいメチル基である請求項 1 記載のピラゾール誘導体又はその塩。
  - 5. R<sup>3</sup> がメチル基である請求項1記載のピラゾール誘導体又はその塩。
- 20 6.

(式中、 $R^1$  及び $R^2$  は前記と同じ意味を示し、 $R^5$  は $C1\sim C3$  アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよいベンジル基を示し、 $R^6$  は $C1\sim C3$  アルキル基を示す。)

5 一般式 [1] で表される化合物と、一般式 [2] で表される化合物とを反応させることを特徴とする、一般式 [3] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。 7.

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$  及び $R^6$  は前記と同じ意味を示し、 $L^1$  はハロアルキル 化して残ったハロゲン原子より反応性の高い脱離基であり、ハロゲン原子、C1 ~C3 アルキルスルホニルオキシ基、C1 ~C3 ハロアルキルスルホニルオキシ 基、置換されていてもよいフェニルスルホニルオキシ基又は置換されていてもよいベンジルスルホニルオキシ基等を示す。)

一般式 [4] で表される化合物と、一般式 [5] で表される化合物とを、塩基 0 の存在下で反応させることを特徴とする、一般式 [6] で表されるピラゾール誘 導体の製造方法。

8.

トリフェニルホスフィン
アグ化合物 [8]
$$R^2$$
 $R^4$ -OH
 $[7]$ 
 $R^6$ 
 $R^1$ 
 $R^4$ 
 $R^4$ 
 $R^4$ 
 $R^4$ 
 $R^4$ 
 $R^6$ 
 $R^6$ 

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びR<sup>6</sup>は前記と同じ意味を示す。)

一般式 [4] で表される化合物とトリフェニルホスフィン、一般式 [7] で表される化合物及びアゾ化合物 [8] とを反応させることを特徴とする、一般式 [6] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

9.

5

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び $R^4$  は前記と同じ意味を示し、 $R^7$  及び $R^8$  は水素原子又は $C1\sim C2$  アルキル基を示し、X はハロゲン原子を示す。)

10 一般式[9]で表される化合物と、ハロゲン化剤とを反応させることを特徴とする、一般式[10]で表されるピラゾール誘導体の製造方法。10.

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>及びXは前記と同じ意味を示す。)

一般式 [10] で表される化合物と化合物 [11] とを反応させることを特徴とする、一般式 [12] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

- 5 11. 上記(10)に記載の一般式[12]で表される化合物を加水分解反応させることを特徴とする、請求項10に記載の一般式[13]で表されるピラゾール誘導体の製造方法。
- 12. 上記 (10) に記載の一般式 [10] で表される化合物と硫化物とを反応 させることを特徴とする、請求項10に記載の一般式 [13] で表されるピラ 10 ゾール誘導体の製造方法。

$$\mathbb{R}^2$$
 ホルミル化 OHC  $\mathbb{N}$  R1 HO [14]

(式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は前記と同じ意味を示す。)

一般式 [14] で表される化合物をホルミル化させることを特徴とする、一般式 [15] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

14.

OHC 
$$\stackrel{R^2}{\stackrel{N}{\stackrel{}}}$$
  $\stackrel{R^4-L^1}{\stackrel{}{\stackrel{}}}$   $\stackrel{E^2}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N^4-L^1}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N^4-L^1}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N^4-L^1}{\stackrel{}}$   $\stackrel{N$ 

5

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びL<sup>1</sup>は前記と同じ意味を示す。)

一般式 [16] で表される化合物と、一般式 [5] で表される化合物とを、塩 基の存在下で反応させることを特徴とする、一般式 [17] で表されるピラゾー ル誘導体の製造方法。

10 15.

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>及びXは前記と同じ意味を示す。)

一般式 [18] で表される化合物をハロメチル化させることを特徴とする、一般式 [19] で表されるピラゾール誘導体の製造方法。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/09762

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C07D231/20			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	
	S SEARCHED		
Int.	ocumentation searched (classification system followed b		·
	ion searched other than minimum documentation to the		
Electronic d CA (S	ata base consulted during the international search (name TN)	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5763359 A (Dow AgroScienc 09 June, 1998 (09.06.98), Registry Number (abbreviated: 188689-50-1 (Family: none)		1–15
А	HEIN, F. et al., "Synthesis of N-(Perfluoro-t-butyl)pyrazoles from Hexafluoroacetone Azine by Trifluoromethyl Group Migration", J.C.S.CHEM. COMM., (18), pp 792-3, (1979), RN: compounds of 73087-70-4, 73087-69-1		1–15
А	US 5536701 A (Monsanto Co.), 16 July, 1996 (16.07.96), RN: compounds of 132631-85-7, 122431-37-2 (Family: none)	179732-64-0,	1-15
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot cons			he application but cited to lerlying the invention claimed invention cannot be cred to involve an inventive eclaimed invention cannot be claimed invention cannot be p when the document is a documents, such a skilled in the art family
31 October, 2003 (31.10.03) 18 November, 2003 (18.11.03)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/09762

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	GAEDE, B.J. et al., "Nobel Perfluoroalkyl-Sub sutituted Pyrazoles., 1. Hydroxypyrazoles", J.Heterocyclic Chem., 30(1), pp49-54, (1993), RN: compounds of 122431-37-2, 132631-85-7, 143706-74-5	1-15
A	HAMPER, B.C. et al., "Cyclocondensation of Alkylhy drazines and β-Substituted Acetylenic Esters: Synthesis of 3-Hydroxypyrazoles", J.Org.Chem., 57(21), pp 5680-86, (1992), RN: compounds of 122431-37-2, 122431-41-8, 129922-58-3, 132631-85-7, 143706-74-5, 143706-75-6, 143706-76-7, 143706-77-8, 143706-79-9, 143706-79-0 143706-80-3, 143706-81-4	1-15
A	PARK, K.H., et al., "Novel Migration of Aryl Group in Pyrazolyl Aryl Ether", Bull.Korean Chem.Soc. 17(2), pp 113-4, (1996), RN: compound of 122431-41-8	1-15
A	HWANG K.J. et al., "SUBSTITUENT INFLUENCED ALKYLATION OF 3-SUBSTITUTED 5-HYDROXYPYRAZOLES: CLAISEN REARRANGEMENT OF 5-ALLYOXYPYRAZOLES", HETEROCYCLES 38(6), pp 1375-80(1993), RN: compounds of 122431-37-2, 143706-45-6, 143706-77-8	1–15
A	HWANG K.J. et al., "Synthesis and Antifungal Activities of 3-Trifluoromethyl-4-Allyl-5-Hydroxy pyrazoles", Korean J. of Med.Chem., 2(2) pp 122-6, (1992), RN: compounds of 146257-29-6, 146257-35-4, 146257-37-6, 122431-37-2	1-15
A	KEES, K.L. et al., "New Potent Antihyperglycemic Agents in db/db Mice: Synthesis and Structure-Activity Relationship Studies of (4-Substituted bezyl) (trifluoromethyl) pyrazoles and-pyrazolones", J.Med.Chem., 39(20), pp 3920-28(1996), Scheme 1.	7-15
P,A	WO 02/062770 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.), 15 August, 2002 (15.08.02), RN: compounds of 122431-41-8, 129922-58-3 & JP 2002-308857 A	1-15

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	1 ° C 0 7 D 2 3 1 / 2 0		,
B. 調査を行			
	b小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C	1 <sup>7</sup> C O 7 D 2 3 1 / 2 0		
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、 N)	調査に使用した用語)	
	ると認められる文献		DEPORT OF
引用文献の カテゴリー*	   引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号
A	US 5763359 A (Dow AgroSciences LL Registry Number(以下、RNとする): (ファミリーなし)	.c.) 1998.06.09	1-15
A	HEIN, F.,他,"Synthesis of N-(Perffrom Hexafluoroacetone Azine by T Migration", J.C.S.CHEM.COMM. (18) pp792-3 (19 RN:73087-70-4,73087-69-1の化合物	rifluoromethyl Group	1-15
区 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 . 31.10.03 国際調査報告の発送日 3.11.03			3
		特許庁審査官(権限のある職員) 守安 智	4 C 8 5 1 9
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3452			) 内線 3452

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する   請求の範囲の番号
A	US 5536701 A (Monsanto Company) 1996.07.16 RN:132631-85-7,179732-64-0,122431-37-2の化合物 (ファミリーなし)	1-15
A	GAEDE, B.J.,他,"Nobel Perfluoroalkyl-Substituted Pyrazoles. 1. Hydroxypyrazoles", J. Heterocyclic Chem. 30(1) pp49-54 (1993) RN:122431-37-2,132631-85-7,143706-74-5の化合物	1-15
A	HAMPER, B.C.,他,"Cyclocondensation of Alkylhydrazines and β-Substituted Acetylenic Esters: Synthesis of 3-Hydroxypyrazoles", J. Org. Chem. 57(21) pp5680-86 (1992) RN:122431-37-2,122431-41-8,129922-58-3,132631-85-7,143706-74 -5,143706-75-6,143706-76-7,143706-77-8,143706-78-9,143706-79 -0,143706-80-3,143706-81-4の化合物	1-15
A	PARK, K.H.,他,"Novel Migration of Aryl Group in Pyrazolyl Aryl Ether", Bull. Korean Chem. Soc. 17(2) pp113-4 (1996) RN:122431-41-8の化合物	1-15
A	HWANG K. J., 他, "SUBSTITUENT INFLUENCED ALKYLATION OF 3-SUBSTITUTED 5-HYDROXYPYRAZOLES: CLAISEN REARRANGEMENT OF 5-ALLYOXYPYRAZOLES", HETEROCYCLES 38(6) pp1375-80 (1993) RN:122431-37-2,143706-75-6,143706-77-8の化合物	1-15
A	HWANG K.J.,他,"Synthesis and Antifungal Activities of 3-Trifluoromethyl-4-Allyl-5-Hydroxypyrazoles", Korean J. of Med. Chem. 2(2) pp122-6 (1992) RN:146257-29-6,146257-35-4,146257-37-6,122431-37-2の化合物	1-15
A	KEES, K.L.,他, "New Potent Antihyperglycemic Agents in db/db Mice: Synthesis and Structure-Activity Relationship Studies of (4-Substituted bezyl)(trifluoromethyl)pyrazoles and -pyrazolones" J. Med. Chem. 39(20) pp3920-28 (1996) Scheme 1.	7–15
PA	WO 02/062770 A1 (クミアイ化学工業株式会社)2002.08.15 RN:122431-41-8,129922-58-3の化合物 & JP 2002-308857 A	1-15